

工 学 部 Vol. 63, No. 1 2023

目次

論文
アモルファス二硫化ゲルマニウム膜の作製過程が銀のフォトドーピングに与える影響
円板を用いた圧電振動発電の特性に及ぼす振動モードの影響
Profit Sharing 法を用いた追跡問題における視野領域を考慮した学習方法の提案
澤田志門・奥山 淳15

音波波形の時間微細構造から見たアクリル板設置による聞き分け低下の要因とその簡易改善法

2023年度 新任教員研究紹介

PROCEEDINGS OF THE SCHOOL OF ENGINEERING OF TOKAI UNIVERSITY CONTENTS

VOL. 63, No. 1 2023

Technical Papers

Effect of Fabrication Process of Amorphous Germanium Disulfide Films on Silver Photodoping
····· Yuma NOTO, Yoshihisa MURAKAMI and Takehisa SHIBUYA 1
Effect of Vibration Mode on the Characteristics of Piezoelectric Power Generation with a Circular Plate
Proposal of a Profit Sharing Method for the Pursuit Problem Considering Field of View
Shimon SAWADA and Atsushi OKUYAMA15
Undesirable Effect of Acrylic Partitions on Speech Recognition and a Simple Improvement Method Estimated by the Temporal Fine Structure
of Speech Sound Waveforms
Ayu YAMAMOTO, Yui YASAKA and Tetsuro HORIKOSHI23
Effect of Solution Mixing Condition on the Quality of Isolated Plasmid DNA by the Alkaline-SDS Method
Noboru SASAGAWA, Hibiki KOBAYASHI and Ryunosuke MIMURA31

Introduction of research activities of new faculty members (2023) School of Engineering ······Nobuyuki ARAI...39

アモルファス二硫化ゲルマニウム膜の作製過程が 銀のフォトドーピングに与える影響 ^{能登} 勇真^{*1} 村上 佳久^{*2} 渋谷 猛久^{*3}

Effect of Fabrication Process of Amorphous Germanium Disulfide Films on Silver Photodoping

by

Yuma NOTO^{*1}, Yoshihisa MURAKAMI^{*2}, and Takehisa SHIBUYA^{*3} (Received on Apr. 9, 2023 and accepted on Jul. 6, 2023)

Abstract

Silver photodoping into an amorphous chalcogenide layer is expected to be applied to various optical devices and optical information recording materials. To understand the optical diffusion of silver, amorphous GeS_2 films deposited on Si substrates were fabricated under different conditions. Photodoping processes were investigated by X-ray reflectivity. The results showed that a reaction layer originating from the fabrication conditions is formed at the boundary between Ag and GeS₂, and this layer affects the optical diffusion of Ag.

Keywords: Silver photodoping, Amorphous chalcogenide, Germanium disulfide

1. まえがき

フォトドーピングとは金属とアモルファスカルコゲナ イド(以後 a-Ch)の二層膜に a-Chの吸収端近傍の光を 照射することで金属が a-Ch中へ異常拡散する現象で, Kostyshinらによって発見された^{1,2)}.金属が a-Ch内にド ープされた領域は反射率が大きく変化する.この現象を 利用することで,パターンが描かれたマスクを通して光 照射する,光束を走査する,あるいは光の干渉・回折を 利用することで,光学デバイスや情報記録材料としての 応用が期待されている.

フォトドーピングのメカニズムについては,最近, Ag/GexS100-x (x=20, 33, 40)の X 線反射率(以後 XRR),中 性子反射率(以後 NR)の測定が行われ,この組み合わ せの膜構造で,膜厚方向の銀の拡散プロセスが明らかに されつつある³⁻⁶. XRR および NR 測定から, Ag 膜, a-Ch 膜,反応膜の厚みが 10⁻¹ nm オーダーで推定されるとと もに,これらの膜の構造,密度と関係する散乱長密度の 導出が可能になる.

a-Ch へのフォトドーピングは金属/a-Ch 界面における 光反応が引き金となっていると考えられる.そのため, 界面状態の違いがフォトドーピングの進行に大きく関わ ると予想される.実際, induction period と呼ばれる,光

- *1 電気電子工学専攻修士課程
- *2 筑波技術大学
- *3 東海大学理系教育センター 教授

照射してもフォトドーピングが見かけ上起こらない時間 帯が存在する場合があるが、その存在の有無が薄膜作製 法に依存し、界面状態の違いによって生じていると考え られている^ヵ.

真空蒸着法により作製された銀/二硫化ゲルマニウム (以後 Ag/ GeS2) 薄膜については、GeS2蒸着後、Ag 膜 をつける前の GeS2 膜のアニール処理の有無がフォトド ーピングに影響する可能性がある.

本研究では GeS2 薄膜の成膜後のプロセスの違いによって Ag 膜との界面状態がどのようになるのか, さらに 光照射した際, フォトドーピングングにどのような違い が表れるかを解析したので報告する.

2. 実験の概要

2.1 フォトドーピング試料の作製

真空蒸着装置を用いて GeS2 および Ag の薄膜を作製した.真空度は 6.0×10⁻⁴ Pa 程度である.膜厚は水晶振動子型膜厚モニターを使用した.下地基板には Si ウエハーを 用いた.一層目の GeS2 を膜厚が 200 nm になるように成 膜した.GeS2 膜は,成膜後大気に戻す場合には,アニー ル処理を行うものと行わないもの,大気に戻さずアニー ル処理をしないものの計三種類である.これらの処理を 行った試料に対して二層目の Ag を 30 nm 成膜した.い ずれの場合でも成膜後は蒸着装置内で 2時間放置した. 成膜後試料を真空容器から取り出す際には大気圧になる までアルゴンガスを導入した. (1) アニール処理有

真空容器から取り出した試料は大気にさらされた後, チューブ型電気炉を用いてアニール処理を行った.パイ レックス管の中に試料をセットし,アルゴンガスを約 100 sccm流しながら約 205 ℃で2時間加熱処理を行った. その後は室温になるまで自然冷却した.その後二層目の Agを成膜した.

(2) アニール処理無

(1)と同じように大気にさらされるが、アニール処理を 行わず再び真空装置の中にセットし、二層目の Ag を成 膜した.

(3) 連続成膜

GeS2 薄膜を成膜した後真空容器から取り出さない試料は,真空状態のまま2時間経過した後Agを成膜した. 大気にさらされること無く二種類の膜は成膜されているがアニール処理されていない試料となる.

2.2 フォトドーピング過程のX線反射率測定

X 線反射率法は,X 線を物質表面すれすれに入射させ, その入射角度に対する X 線反射率の依存性を調べるこ とで, 膜厚, 密度, 表面や界面のラフネスといった膜構 造パラメータを求める手法である. この手法は非破壊検 査であり, それぞれの膜のパラメータをフィッティング 解析から求めることで多層膜の解析ができる.

Agのフォトドーピング過程を XRR 測定する際の装置の配置を Fig. 1 に示す. X 線回折装置 (Philips (PANalytical)製 X'Pert MRD, Cu ターゲット, K_a)内にフォトドーピング用の波長 405 nmの半導体レーザーを設置した. X線回折装置内の様子を Fig. 2 に示す.レーザー光はスペイシャルフィルター (10 倍の対物レンズ, 25 µm のピンホール)によりビームノイズを取り除いた.照射光強度は,約 7 mW/cm² であった.半導体レーザーの照射領域は X線の測定領域とは重ならないようにした. X線の入射角度 0.1~1.5 度の範囲で X線反射率測定を行なった.



Fig. 1 Schematic diagram of X-ray reflectivity.

光を照射する前に XRR 測定を行い試料の初期状態を 計測した (Before). その後ステージを移動させレーザー 光照射領域で所望の時間,光を照射した. その後再び測 定領域へと移動し XRR 測定を行った. これらの過程を 繰り返し,照射時間に対する Ag のフォトドーピング過 程を観測した. 照射時間はステージが光照射領域にいる 時間とした.



Fig. 2 Experimental setup of XRR for photodoping process.

試料への LD の照射時間は,アニール有の試料,アニ ール無の試料では1~4回は15分間とし,その後は30 分間とした.連続成膜の試料については5分間とした. (1)の試料は全体で15時間照射,(2)の試料は全体で12時 間照射,(3)の試料では全体で3時間照射した.

測定された XRR スペクトルの解析ソフトウエアとし て Motofit を使用した⁸⁾. モデル薄膜における散乱ベクト ル(Q)と X 線反射率(R)と実験で得られたスペクトルの関 係から, Ag, GeS₂等の膜厚,散乱長密度実部(以後 SLD) 等を求めることが出来る. SLD は構成元素と密度で決ま る値である,膜構造を解析する際,想定している原子を 含む膜であるかの指標となる.光照射時間に対する XRR スペクトルから Ag, GeS₂の等の膜厚, SLD 等を求める ことで Ag のフォトドーピング過程を観測した.

3. 結果

3.1 X線反射率スペクトルとフィッティング

(1) アニール処理有

アニール処理をした試料における XRR スペクトルの 光照射時間依存性とそのフィッティング結果を Fig. 3 に 示す.フィッティングの精度を示す χ^2 は 0.005~0.0251 であった.15 分間の光照射で光照射前にあったフリンジ が無くなっている事がわかる.散乱ベクトル Q の 0.5~0.8 nm⁻¹ の領域について反射率の急激な落ち込みが光照射 15 分から始まり 90 分頃まで続いた.

(2) アニール処理無

アニール処理をしていない試料における XRR スペク トルの光照射時間依存性とそのフィッティング結果を Fig. 4に示す.フィッティング精度, χ^2 は 0.005~0.0251 であった.(1)の試料と同様に 15 分の光照射で光照射前 にあったフリンジが無くなっている事がわかる.散乱ベ クトルQの 0.5~0.8 nm⁻¹の領域について反射率の急激な 落ち込みが(1)の試料と比較して光照射 15 分から 45 分 までと短くなった.



Fig. 3 XRR spectra and model fitting curves (annealed sample).



Fig. 4 XRR spectra and model fitting curves (non-annealed sample).



Fig. 6 SLD spatial distribution versus exposure time (annealed sample).



Fig. 7 SLD spatial distribution versus exposure time

(non- annealed sample).



Fig. 5 XRR spectra and model fitting curves (non-annealed sample without atmospheric exposure).

(3) 連続成膜

真空中で2種類の膜を成膜した連続成膜の試料における XRR の光照射時間依存性とそのフィッティング結果を Fig. 5 に示す.フィッティング精度 χ^2 は 0.008~0.03であった.照射時間 45 分で光照射前にあったフリンジが 無くなっている事が分かる.光照射時間 45 分 から Q の 0.3~0.5 nm⁻¹ の範囲において新しいフリンジが観測された.

3.2 SLD および膜厚プロファイル

3 種類の試料の厚さ方向の SLD プロファイルを Fig. 6~8 に示す. Ag の SLD は 77×10⁻⁴ nm⁻²程度で GeS2 は 20 ×10⁻⁴ nm⁻²程度である.光照射は Ag 側(グラフ左側か

GeS₂ Before 5 min 10 mln SLD (x 10⁻⁴ nm⁻²) 15 mln 20 mln 45 mln 60 mln 75 mln 120 mln 100 150 200 250 0 50 Thickness (nm)

Fig. 8 SLD spatial distribution versus exposure time (non- annealed sample without atmospheric exposure).



Fig. 9 SLD profiles of sample before the light exposure produced by different fabrication processes.

ら右に向けて)から行った.光照射を行う前の XRR ス ペクトルから膜構造を解析する際, Ag と GeS2の膜の他 に両者の境界面に反応層(Reaction)を仮定した方がフィ ッティング精度の値が良くなった.光照射を行う前の反 応層付近の SLD の拡大図を Fig. 9 に示す. GeS2 を成膜し た後アニール処理を行った場合,反応層は 5.5 nm 程度, アニール処理を行わない場合には 8.0 nm の膜厚である と考えられる.一方で連続成膜の場合には反応層が厚く 15 nm 程度になることが分かった.

(1) アニール処理有

アニール処理を行った試料のそれぞれの膜厚変化を Fig. 10 に示す. SLD の変化と膜厚変化のグラフから,光 照射前には Ag の SLD を持つ膜が試料表面に 30 nm 程度 存在していたが, 15 分間の光照射後には Ag 膜は消失し た. その代わりに照射前に存在していた反応層の SLD の



Fig. 10 Film thickness versus exposure time (annealed sample).

値が上昇した.反応層の SLD の値は光照射時間の経過に 伴って減少した.反応層の膜厚に関しても.照射時間の SLD は上昇していった. 120 分の段階で両者の値は同じ になり, SLD が一致した膜となった.GeS2の膜厚は光照 射に伴い増加していった.その後も光を照射し続けると 試料の表面に SLD が小さい表面層(Surface layer)が形 成された.

(2) アニール処理無

アニール処理をしていない試料についてそれぞれの膜 厚変化を Fig. 11 に示す. Ag の SLD を持つ膜は光照射が 15 分で無くなり,その後かなり早い段階で表面層が形成 されたと考えられる.反応層の SLD の減少および GeS₂ の SLD の増加はアニール処理をした試料と比べて早く, 30 分の光照射で SLD の値は近くなった. 60 分後には両 者の SLD が一致した膜になった.



Fig. 11 Film thickness versus exposure time (non-annealed sample).

(3) 連続成膜

GeS2 成膜後大気にさらされない試料のそれぞれの膜 厚変化を Fig. 12 に示す. Fig. 8の SLD プロファイルから, 光照射と共に Ag は次第に薄くなり. SLD の値も減少し た.この試料においても 15 分の光照射で Ag の SLD を 持つ膜は消失した.反応層の SLD は銀の消失とともに上 昇するが,その後低下していく.反応層の SLD の減少に 伴い GeS2の SLD が上昇してきた.表面層は 20 分照射後 に形成され,60 分後に消失した.120 分後には両者の SLD の値は一致した膜となった.

4. 考察

4.1 試料の膜構造

試料としては Ag と GeS2の2層構造で成膜したが,光 照射する前の試料に対しての XRR スペクトル解析の結 果,いずれの試料においても反応層が確認された.



Fig.12 Film thickness versus exposure time (non-annealed sample without atmospheric exposure).

アニール処理を行うことによって GeS₂ は膜全体とし てほとんどの Ge と Ch の結合がなされたものと考えられ る.アニール処理をした GeS₂の上に Ag を成膜した場合, 表面近傍の部分までしか Ag が侵入できないため,反応 層の厚さは薄くなっている.

ー方アニール処理を行っていない GeS₂ は Ge-Ch の ネットワークの再構築は行われないため Ge-Ch 結合が 切断されたものも多い.アニールしていない GeS₂の場合 は比較的深くまで Ag が侵入したため反応層の厚さが厚 くなったと考えている.またアニール処理をしていない が一度大気にさらされた試料は,酸素との結合が一部で 発生するため銀の侵入が制限され,反応層の膜厚は連続 成膜のものよりは薄くなったと考えられる.

4.2 Agのフォトドーピング

GeS2 膜内の拡散には Ge と Ch 原子ネットワークが関係している⁹. GeS2 中の Ge—Ch 結合が切断され, Ch サイトに Ag を捕獲する空隙が出来ると考えられている. 光が照射されると Ag は最初にこの反応層内の Ch の空隙 に取り込まれる. Ag を取り込んだ反応層の SLD は上昇 するが,光照射が進むにつれて反応層内の Ag は GeS2 内 へと拡散していく. そのため反応層の SLD は減少し, GeS2 の SLD は上昇していく. 最終的にはこれらは一致 した膜となる.

表面に存在していた Ag はいずれの試料作製条件においても光照射を行うと 15 分程度で消失した. しかしながら SLD が高くなった反応層から GeS2 膜全体に Ag が均質に拡散するには 60 分から最長で 120 分であった. 反応層の膜厚が薄かったアニール処理をした試料の場合,反応を起こすためのポテンシャル障壁が高いため,光照射による界面反応が遅かったと考えられる. 光照射によっ

てもネットワークの切断が進まず, Ag の拡散に長い時間 を必要とした.大気にさらされることなく二層を成膜し た試料に関しては,光照射後の反応層の SLD の値は高く, 膜が厚くなった.これは GeS2 が大気中の酸素と反応して いない為, Ag を捕獲する原子がより多く存在するためだ と考えられる.

いずれの試料も GeS₂の膜厚はフォトドーピングが進行するにしたがって厚くなっている. Ag/As₂S₃の場合は 非晶質の構造が 2 次元的配置の中に Ag が入り込むこと によって 3 次元的に変形するため体積膨張が発生する¹⁰⁾. GeS₂の場合は 3 次元的配置であるが, Ch の空隙へ Ag が 侵入することによるひずみが生じ,結果的に膜厚が厚く なったと考えられる.

いくつかの XRR スペクトルにおいては最表面に SLD の小さい表面層を導入した方がフィッティングの精度が 高くなった.この表面層の SLD は GeS2の値よりも小さ い.大気にさらされた試料については SLD が同一となっ た後も光照射を続けた場合発生し、大気にさらされてい ない試料では Ag が消失してすぐに発生し、しばらくし て消失した.表面層については他の測定を行うなどして 実在を確かめる必要がある.

5. 結言

真空蒸着法で成膜したアモルファス GeS2 薄膜への Ag のフォトドーピング過程について XRR スペクトル法を 用いて観測した.スペクトル解析から GeS2と Ag との界 面に反応層が存在する事が明らかになった.この反応層 の厚さは GeS2 の処理方法により異なることが分かった. 今回実験した GeS2 が 200 nm の下地の上に Ag が 30 nm 成膜した試料に,波長 405 nm,照射光強度 7 mW/cm² の LD 光を照射した場合,試料の処理方法にかかわらず Ag は 15 分程度で表面から消失した. Ag のフォトドーピン グ過程は,反応層への Ag の拡散と,反応膜から GeS2 へ の拡散の 2 つの過程が同時進行している.そのため膜の SLD が均質になるまでの時間はフォトドーピングを行う 前の反応層の厚さだけでは決まらないことが分かった.

X線反射率法により埋もれた界面状態を測定すること が出来,試料の処理方法の違いによる銀のフォトドーピ ング過程の違いを明らかにした.

謝辞

本研究を行うにあたり,薄膜の MRD による XRR 測定, Dektak による膜厚測定など,多くの分析装置を利用させ ていただきました,東海大学研究推進部技術共同管理室, 森川真希氏,小田慶喜氏に御礼申し上げます.

X線反射率測定のデータ解析に関してご指導いただき ました CROSS 坂口佳史主任研究員には心より御礼申し 上げます.X線反射率測定のデータ解析において,とも に研究生として参加した渋谷研究室修士課程1年生の加 茂直紀氏に協力いただき感謝いたします.X線反射率の データ解析は CROSS 研究生制度の支援を受けたもので, 関係者の皆様に心より御礼申し上げます.

参考文献

- M. T. Kostyshin, E. V. Mikhailovskaya and P. F. Romanenko: Photographic sensitivity effect in thin semiconducting films on metal substrates, Sov. Phys. Solid State, Vol. 8, pp. 451-452 (1966).
- Y. Murakami and M. Wakaki: Observation of Ag photodoping phenomena in GeS₂ chalcogenide glass films by spectroscopic ellipsometry and atomic force microscopy, Thin Solid Films Vol. 542, pp. 246-250 (2013).
- 3) Y. Sakaguchi, Y. Sakaguchi, T. Hanashima, Al-Amin. A. Simon, M. Mitkova: Excitation light energy dependence of Silver photodiffusion into amorphous Germanium Sulfide: Neutron and X-Ray reflectivity and S-ray diffraction, Phys. Status Solidi B Vol. 257, p. 2000178 (2020).
- 4) Y. Sakaguchi, T. Hanashima, Al-Amin. A. Simon, M. Mitkova: Silver photodiffusion into amorphous Ge chalcogenides-Excitation photon energy dependence of kinetics probed by neutron reflectivity, Eur. Phys. J. Appl. Phys. Vol. 90, p. 30101 (2020).

- 5) Y. Sakaguchi, H. Asaoka, Y. Uozumi, K. Kondo, D. Yamazaki, K. Soyama, M. Ailavajhala, M. Mitkova: Silver photo-diffusion and photo-induced macroscopic surface deformation of Ge₃₃S₆₇/Ag/Si substrate, J. Appl. Phys. Vol. 120, p. 055103 (2016).
- Y. Sakaguchi, H. Asaoka, M. Mitkova: Silver photodiffusion into Ge-rich amorphous germanium sulfide – neutron reflectivity study, J. Appl. Phys. Vol. 122, p. 235105 (2017).
- A. V. Kolobov, S. R. Elliott: Photodoping of amorphous chalcogenides by metal, Adv. Phys. Vol. 40, pp. 625 -684 (1991).
- A. Nelson: Co-refinement of multiple-contrast neutron / X-ray reflectivity data using MOTOFIT, J. Appl. Crystallogr. Vol. 39, pp. 273-276 (2006).
- 9) G. Kluge: A new interpretation of the photodoping effect in amorphous As- and Ge-chalcogenides, Phys. Stat. Soli. (a) Vol.101, pp. 105-114 (1987).
- 10) 村上佳久,佐田康幸,若木守明: 非晶質 GeS2 薄膜への Agのフォトドーピング現象に関する研究,東海大学紀要工学部 Vol. 48, pp. 33-40 (2008).

円板を用いた圧電振動発電の特性に及ぼす振動モードの影響 呉 文宝^{*1} 森山 裕幸^{*2} 土屋 寛太朗^{*3} 内田 ヘルムート貴大^{*4}

Effect of Vibration Mode on the Characteristics of Piezoelectric Power Generation with a Circular Plate

by

Wenbao WU^{*1}, Hiroyuki MORIYAMA^{*2}, Hirotarou TSUCHIYA^{*3} and Helmut Takahiro UCHIDA^{*4} (Received on Mar. 31, 2023 and accepted on Jul. 19, 2023)

Abstract

In this study, a circular plate of constant thickness, on which a piezoelectric element was installed, was adopted as the host structure of an energy-harvesting system. The plate was supported at its end having some stiffness, which was intermediate between simple and clamped supports, and was subjected to a harmonic point force. The piezoelectric performance of the system greatly depended on the vibration characteristics of the plate. Regarded as one of the representative vibrational characteristics, the natural frequency of the plate was affected not only by the dimensions, support conditions, and vibration modes of the plate, but also by how the piezoelectric element was installed. Therefore, the location of the piezoelectric element varied the natural frequency, thus affecting the conversion of vibration energy into electrical energy through the piezoelectric effect. The theoretical results confirmed that the natural frequencies of the plate in each vibration mode can be reduced to the respective lowest frequencies by attaching a piezoelectric element at the location where the maximum amplitude occurs. The effect of attachment gradually weakens as the piezoelectric element is moved towards the support. Moreover, when the center of the plate is within the piezoelectric portion, the power generation efficiency is relatively high. But, when the center deviates from this area, the power generation efficiency drops rapidly.

Keywords: Piezoelectric element, Circular plate, Electricity generation, Efficiency, Vibration mode



近年エネルギー需要の高まりからソーラーエネルギー, 風力発電などの再生可能エネルギーやエナジーハーベス トに関する研究が注目され,その中の一つにエネルギー の有効利用の観点から振動発電の研究が活発に進められ ている.圧電振動発電とは圧電素子を振動体に直接貼付 し,物体の振動エネルギーを圧電素子に生じるひずみの 変動を通して電気エネルギーに変換する発電方法である ¹⁾.

圧電型は振動に伴う圧電材料の変形により誘起され た圧電効果に基づく発電方式で、逆磁歪型は振動を受け るコイルに内包した逆磁歪材料の変形で発現した逆磁歪 効果により電磁誘導を誘起することで発電する.逆磁歪 型は素子を変形させるという点では圧電型と似ているが、 疲労強度の高い材料を選択すれば相対的に加工性が優れ ていることから、圧電型に比べて自由度の高い設計が可 能である.一方、圧電型は構造が単純かつ丈夫で小型化 も容易なため、様々な製品に使用されている.しかし発 電時の電圧が高い反面、電気抵抗が大きく電流が取り出 し難いことから、電力を確保するために圧電素子を積層 や、振動を応力として効果的に素子に伝えるための工夫 が必要である.特に圧電素子の積層数と加振周波数の増 加は発電時の電圧及び電力を増大させるが、それらの増 加率は飽和する傾向にある^{2,3)}.

振動を応力として効果的に素子に伝えるためにホス ト構造としてはり構造を用いることが多く,一般的に圧 電素子の貼付方法にはモノモルフやバイモルフが採用さ れている.多くの先行研究の中で,圧電素子を片持ちば りの両面に貼付したバイモルフの圧電振動発電装置に関 し,強制変位による振動入力パワーと減衰による散逸パ ワーの差分が電力に変換されると仮定し,振動入力エネ ルギーから電気系のエネルギーへの変換効率をエネルギ ーバランス式から導出されている^{4,5}).上記の通り,ホス ト構造に生じる応力に起因したひずみ成分は発電特性と 密接な関係があり,はり構造では幅方向のひずみ特性は 一様になるものと想定しているので,長手方向の特性の み注目することになる.当然ながら幅の拡大は幅方向の

^{*1} 工学研究科機械工学専攻修士課程

^{*2} 工学部機械システム工学科教授

^{*3} 工学部機械システム工学科助教

^{*4} 工学部機械工学科准教授

ひずみ特性に変化を生じさせ,2次元構造として取り扱わなければならないため解析的な取り扱いはやや複雑になるが⁶,その成果の汎用性は高まることになる.

そのため本研究では円板構造をホスト構造とした圧電 振動発電システムを取り上げ,その発電特性に直接関与 するひずみ特性は円板寸法,材質,支持条件及び振動モ ード等に影響される.一方,本システムでは円板表面に 生じるひずみ成分から圧電素子を通して電気エネルギー を回収するため,発電特性は圧電素子の貼付位置にも強 く影響される.そこで本報告では円板寸法,材質及び支 持条件が一定の下,圧電素子の貼付位置を変化させたと きの固有周波数,面外変位及び面内変位(ひずみ)を含 む振動特性に注目した.これらの振動特性を踏まえ,本 システムの発電特性は貼付位置の影響を振動モード間の 比較から検討され,特性改善に合理的な設置方法を提示 する.

2. 解析方法

本理論解析に用いた基本的な解析モデルを Fig. 1 に示 す. 円板は周辺に均等に分布したばね定数が Tの直線ば ねと Rの回転ばねにより支持されている. 半径 r_c と板厚 h_c の円板中心には, 半径と厚みがそれぞれ r_p $L h_p$ の圧電 部及び r_b $L h_b$ の電極部で構成された圧電素子が貼付さ れている. 座標は面内方向を $r \ge \theta$, 面外方向を z で表記 し, 円板は r_e , θ_e の位置に点加振力 F が付加され, 加振 周波数は円板の固有周波数としている.

円板の面外変位 w_c は A^s_{nm} 及びモード形を含む式(1)で 表現し,以後の解析では基底関数として用いられる⁽²⁾. ただし本解析では,圧電素子は円板に完全密着している ものと仮定している.

$$w_c = \sum_{s=0}^{1} \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} A_{nm}^s \sin\left(n\theta + \frac{s\pi}{2}\right) \left(\frac{r}{r_c}\right)^m.$$
 (1)

nとmは円板の振動モードにおける円周方向(θ方向)と 半径方向(r方向)の節線数を示し、以後振動モードは (n,m)で表記する.加振時の円板に蓄えられる弾性ひずみ エネルギーは面外変位(面内ひずみ)が極大化する箇所 で大きくなるため、その箇所が最も少ない(0,0)次モード では円板中心付近に集中し易くなる.本研究では(0,0)次



Fig. 1 Analysis model.

モードの発電特性を高次モードにおける特性との対比で 検討する際,(1,0)次モードは妥当な振動モードの一つに 挙げられるため,(0,0)次と(1,0)次モードに注目している. また s は振動モードの対称性を表す指標, A^s_{nm}は以後面 外変位の決定に必要な係数であり,円板振動における振 幅に対応する.

円板と圧電素子が有する運動エネルギーとポテンシャ ルエネルギー等を含むラグランジュ関数に式(1)を適応 し、 δw_c から求めたオイラー方程式(2)が機械的な支配方 程式に相当する.一方,圧電部に生じる電圧 v_p の第一変 分から求めたオイラー方程式(3)が,電気系の支配方程式 と見なせる.

$$\sum_{m'=0}^{\infty} \left[K_{cnmm'}^{s}(1+j\eta_{c}) + K_{pnmm'}^{s}(1+j\eta_{p}) + K_{bnmm'}^{s}(1+j\eta_{b}) + r_{c}F_{sn} \left\{ T + \left(\frac{m}{r_{c}}\right) \left(\frac{m'}{r_{c}}\right) R \right\} - \omega^{2} \left(M_{cnmm'}^{s} + M_{pnmm'}^{s} + M_{bnmm'}^{s} \right) + X_{nm'}^{s} \left[e^{j\omega t} - \sum_{m'=0}^{\infty} \beta v B_{nm'}^{s} e^{j\omega t} = \mathbf{F}_{nm}^{s} e^{j\omega t}, \qquad (2)$$
$$\sum_{m'=0}^{\infty} C_{p}^{-1} \beta A_{nm'}^{s} = \sum_{m'=0}^{\infty} \left(j\omega R_{cir} + C_{p}^{-1} \right) B_{nm'}^{s}. \qquad (3)$$

上記式(2)における $K^{s}_{cnnm'}$, $K^{s}_{pnnm'}$, $K^{s}_{bnnm'}$ と $M^{s}_{cnnm'}$, $M^{s}_{pnnm'}$, $M^{s}_{bnnm'}$ は, 円板, 圧電部, 電極部の剛性マトリ ックスと質量マトリックスの要素をそれぞれ示したもの である.また η_{c} , η_{p} , η_{b} は円板, 圧電部, 電極部の減衰係 数を意味し, F_{sn} は $n \geq s$ で決定される係数である.さ らに \mathbf{F}^{s}_{nm} は加振力ベクトルであり,(0,0)次及び(1,0)次の固 有モードに対応した角周波数 ω で円板に付加される.

電気系の支配方程式おける C_p は圧電素子の静電容量 であり、 β は電気系と機械系間の連成係数である.また R_{cir} は電力消費用回路の抵抗であり、 $B_{nm'}^{s}$ は電荷の振幅を それぞれ示している.

以上は円板中心に圧電素子を貼付した解析モデルの説明であるが、本研究では圧電素子の設置位置及び設置数 を変化させている. Fig. 2 に示す通り、圧電素子を円板中 心から距離 e だけ偏心させ、x 軸から&だけ回転させた 位置に貼付した場合、次式のr座標を用いて表現したラ



Fig. 2 Eccentricity-attached model of piezoelectric

グランジュ関数に変分原理を適用し,式(2),(3)と同様の 手順で機械系と電気系の支配方程式を導出する.

$$r_{1} = e \cos \phi - \left\{ r_{p}^{2} - e^{2} (\sin \phi)^{2} \right\}^{1/2}$$

$$r_{2} = e \cos \phi + \left\{ r_{p}^{2} - e^{2} (\sin \phi)^{2} \right\}^{1/2}$$
(4)

具体的には Matlab による式(2)と(3)の連立計算から $A_{nm'}^{s}$ と $B_{nm'}^{s}$ を決定し、 $A_{nm'}^{s}$ からは振動速度に基づく機械的な供 給パワー P_{m} を、 $B_{nm'}^{s}$ からは発生電圧に基づく電力 P_{e} をそ れぞれ求める。本解析結果における発電性能を評価するた め、上記 P_{m} と P_{e} より発電効率が以下のように定義されて いる。

$$P_{em} = \frac{P_e}{P_m} \times 100 \, [\%].$$
 (5)

結果及び考察

3.1 円板の振動特性

解析モデルは半径 r_c = 153 mm のアルミニウム合金製円板 を想定しており, 板厚 h_c には 3.0 mm を選択した. 円板はば ね定数が $T \ge R$ の直線ばねと回転ばねで周辺が支持されて いるが,支持条件は曲げ剛性 $D = [Eh_c^3/\{12(1-v^2)\}]$ を用いた 無次元ばね定数 T_n (= Tr_c^3/D) $\ge R_n$ (= Rr_c/D) で表現される.



Fig. 3 Changes in natural frequency due to position of

piezoelectric element.

このようなばね支持を採用した解析モデルでは、 $T_n = 10^{8.0}$ と $R_n = 0$ で単純支持、 $T_n = 10^{8.0}$ と $R_n = 10^{8.0}$ で固定支持を表現で きる. ただしこれらの支持条件を実験で再現するのは非常 に困難であるため、本研究では $T_n = 10^{8.0}$ のままに $R_n = 10^{1.0}$ とした中間的な弾性支持を採用した.

上記円板表面には, 圧電部 ($r_p = 12.5 \text{ mm}, h_p = 0.53 \text{ mm}$) と電極部 ($r_b = 17.5 \text{ mm}, h_b = 0.30 \text{ mm}$) で構成された圧電素 子を貼付した. 貼付位置は $r = 0 \text{ mm}, \theta = 0$ °の円板中心 (x = 0 mm, y = 0 mm) から, $\theta = 90$ °の r 軸上 (y 軸上) を移 動させたが (Fig. 1 を参照), 移動量は圧電素子の偏心距 離 e で表現されている (Fig. 2 を参照). 一方, 加振位置 は圧電素子の移動領域とx 軸に関して対称領域に設定す るため, $r_e = 61 \text{ mm}, \theta_e = 270$ °とした.

円板の振動特性を的確に評価できる指標の一つに,固有 周波数が挙げられる.Fig.3は円板表面に圧電素子を貼付し たときの(0,0)次及び(1,0)次モードにおける固有周波数 f, について,貼付位置の偏心距離 e による推移を示したもの である(黒線).比較のために,圧電素子を貼付していない 円板のf,も提示している(赤線).まずFig.3(a)における(0,0) 次モードにおいては,f,は圧電素子の中央貼付(e = 0 mm) からeと共に増加し,最大偏心位置(e=135 mm)において 圧電素子が未貼付のf,に達している.これは円板の振動特 性が圧電素子の貼付によって影響されることを意味し,そ



Fig. 4 Out-of-plane displacement distribution.

の影響は偏心量の増大に伴い弱められていることを示唆している.この影響は式(2)に示す通り,圧電素子に関する剛性・質量マトリックスに依存することになる.特に圧電素子の貼付位置が(0,0)次モードでは円板中心 (e = 0 mm)付近, (1,0)次モードではe = 50 mm付近で, f_r の低減が顕著に現れている.

このような f,の低減を検討するため、圧電素子を中心に 貼付した円板について (e=0 mm),(0,0)次及び(1,0)次モー ドにおける面外変位分布を Fig. 4(a)と(b)にそれぞれ示し ている.面外変位 wcの分布特性は振動モードに合致してお り、特に(1,0)次モードでは wc が y 軸上で極大化する振動 姿態を呈するため、本解析で設定した圧電素子の貼付位 置は妥当なものと見なせる.そのため f,の低減が圧電素 子の y 軸上での移動に依存することを考慮すれば、この変 化には質量マトリックスが強く関わるものと推測される. 一方,f,の変動幅を振動モードで比較すると、(0,0)次モード では(1,0)次モードを大きく上回り(約4.6倍),面外変位に おいても(0,0)次モードの最大値は(1,0)次モードの約5.5倍に

達している.これもfrの変化には,質量マトリックスが強く 寄与していることを裏付けている.

円板の固有周波数や振動モードと共に,円板振動時の面 外変位は重要な振動特性の一つに挙げられる.しかし円板 表面に貼付した圧電素子による発電特性に注目するのであ れば、面内変位は圧電効果に直接関わる重要な振動特性と 見なせる.Fig.5(a)と(b)は面内変位から導かれる面内ひずみ の半径方向(r方向)成分&をz軸にとり、(0,0)次と(1,0)次 モードに関する円板全面にわたる&分布をそれぞれ示した ものである.これらの分布特性は&値の増減と極大・極小値 の生成及び振動モード間の大小関係という観点から、wc分 布と類似点が多く見受けられる.しかし極大値(正数値) からの減少過程を検討すると、&は任意の領域を越える と負数値に至ることになる.ただし(1,0)次モードにおけ る極小値からの増加過程では、逆過程を経ることは明ら かである.

Fig. $6(a) \varepsilon(b)$ は面内ひずみの円周方向 (θ 方向) 成分 ϵ_{θ} について、(0,0)次 $\varepsilon(1,0)$ 次モードに関する分布をそれぞれ示したものである.これらの分布特性は ϵ_{r} 分布と同様に、多くの点で w_{c} 分布と類似性が認められる.特に極大値からの減少過程においては、正数値から負数値への符号変換は認められない.当然、(1,0)次モードにおける極小値からの増加過程でも、符号変換しないことを確認できる.

以上のような $\epsilon_{e} \geq \epsilon_{\theta}$ の分布特性を詳細に検討するため, $\theta = 90$ °におけるr軸(y軸の正数値領域)上のひずみ分 布に注目する. Fig. 7 は(0,0)次と(1,0)次モードについて, ϵ_{r} $\geq \epsilon_{\theta}$ の分布を示したものである.これらのデータは Fig. 5, 6 から抜粋したものなので, (0,0)次モードにおける $\epsilon_{r} \geq \epsilon_{\theta}$









はrの増加に伴い単調減少し,(1,0)次モードのひずみ成分で は中心付近においてrと共に増加するが,各ひずみが最大値 に達した後には減少傾向に転じている.

上記のような全体傾向を踏まえた上で各ひずみ成分を検 討すると、 ε はrの増加に伴い各モードの最大値(正数値) から減少し、(0,0)次モードで r/r_c が約 0.57 付近、(1,0)次モ ードでは約 0.78 付近からそれぞれ符号の変換が生じている. このような符号の逆転には θ 軸周りの曲げモーメント M_r の 変化に依存するが、本解析モデルにおける円板の支持条件 は単純支持と固定支持に対して中間的な弾性支持と見なせ、 支持部では固定モーメントに相当する M_r が生じることにな る. 理論上、単純支持では境界条件として $r/r_c=1.0$ のとき $M_r=0$ を想定するが、本解析モデルにおける $r/r_c=1.0$ では 支持部に存在する反モーメントに対応する M_r が存在するた め、上記の符号逆転が生じたものと考えられる. 一方、 ε_0 が (0,0)次と(1,0)次モードでそれぞれ最大値を有し、本図におけ る r/r_c の領域において正数値が維持されることは、Fig. 6 の分布特性を追認する結果である.

これらのようなひずみ特性は発電特性に直接関与するものであるため、 $\epsilon_r \geq \epsilon_{ heta}$ の関係についても言及する. (0,0)次モードにおける $\epsilon_r \geq \epsilon_{ heta}$ の全体特性の相違は上述の通りであるが、両成分はほぼ同値の最大値が円板中心付近に現れている. (1,0)次モードでも全体特性の相違は同様であるが、最大値の大きさにも相違が認められる.特に最大値に関しては、(0,0)次モードのひずみ値が大きく上回っている.

3.2 発電特性と圧電素子の貼付位置との関係

前節で取り上げた円板の振動特性に及ぼす圧電素子の 貼付位置による影響は,固有周波数の変化を示すことに よって確認した.またこの変化は振動モードによって大 きく異なることも示すことができたが,これらの影響は 発電特性にも及ぶことになる.そこで発電特性を評価す るため,発電時の電力を重要な物理量として取り上げる.

Fig. 8(a)と(b)は(0,0)次と(1,0)次モードでそれぞれ生じた 電力 P_e について, Fig. 3 と同様に圧電素子の貼付位置を 円板中心から移行させたときの推移を示している. (0,0) 次モードにおける P_e は e = 12 mm 付近まで相対的に高値 が維持され, それ以後 eの増加に伴い急激に減少して,



Fig. 7 Strain distributions of radial and circumferential directions.

e = 50 mm 以降では発電がほとんど認められない. この P_e の高値が維持される e は圧電部半径 r_p にほぼ一致して おり, 圧電部が円板中心から逸脱すると P_e は減少するこ とを示すものである. (1,0)次モードにおける P_e は円板中 心から e と共に増加し, e = 70 mm で最大値に達するが, 以後減少傾向で推移している. ただし電力は(0,0)次モー ドの P_e に比べ,極めて小さく抑えられている.

このような発電特性を Fig. 7 のひずみ特性との関連で検 討すると,(0,0)次モードにおける P_e が高値に維持される e= 12 mm (e/r_c =7.8×10²)までは, $\epsilon_r \ge \epsilon_{\theta}$ がほぼ同値の最 大値付近を推移している.それ以降 eの増加に伴い両ひ ずみ値共に減少しているが, ϵ_r の減少割合は ϵ_{θ} に比べて顕



Fig. 8 Electric power as function of eccentric distance.



Fig. 9 Mechanical power supplied to the plate as function of eccentric distance.



Fig. 10 Power generation efficiency as function of eccentric distance.

著に大きくなっている.発電がほとんど認められない $e = 50 \text{ mm} (e/r_c = 0.33)$ では、 c_r は大きく減少しているの対して c_0 は相対的にある程度の大きさが維持されている.このような発電及びひずみ特性間の関係は、二次元面内ひずみに由来する圧電効果において、一方向のひずみ成分の大幅な低減が発電特性を大きく損なうことを示唆している. (1,0)次モードでは、 P_e が最大になる $e = 70 \text{ mm} (e/r_c = 0.46)$ において c_0 も最大値に達しているが、この c_0 は c_r に比べて相対的に低値に留まっている.そのため上記の通り P_e の最大値を確認できるもの、その大きさは(0,0)次モードの P_e に比べて極めて小さく抑制されている.

このような発電時の P_e は加振力 Fに依存するが、本解 析は F=1N 一定の下で行われてきた. eの変化に対する 発電特性を P_e で評価する場合、円板に供給される機械的 なパワーが加振周波数と加振点の面外変位に依存するた め、モード間での定量的な比較には問題が残る. そこで 円板に供給される機械的パワー P_m に注目し、(0,0)次と (1,0)次モードにおける P_m の eに対する推移を Fig. 9 に示 す.(0,0)次の P_m には多少の変動が認められるが、各振動 モードでほぼ一定値であることを確認できる.

そこで Fig. 8 における Pe とこの Pm を式(5)に適用して 発電効率 Pem を取り上げ, (0,0)次と(1,0)次モードにおける eに対する推移をそれぞれ Fig. 10(a)と(b)に示す. (0,0)次 モードの P_{em} が e = 12 mm 付近まで相対的に高効率が維 持され、それ以後 e の増加に伴い急激に減少する傾向は Fig. 8(a)の P_eと同様である. このような P_{em} が P_eと類似 な傾向で推移することは(1,0)次モードでも確認でき、その 値も(0,0)次モードに比べて極めて小さく抑えられている.こ の(1,0)次モードにおける $P_e \ge P_{em}$ の抑制には, Fig. 7 にお ける Er と EAの減少及ひずみ値間の差異が関与しているが, そ れに加えてひずみの発生個所にも依存しているものと考え ている. 例えばひずみエネルギーに注目した場合, Fig.7 に おける&とをから導かれるひずみエネルギーについて,円板 中心から遠ざかるに従いそのエネルギーが反映する領域が 拡大することになる、その結果、エネルギー密度(単位面積 当たりのエネルギー)は、同じひずみ値であっても中心から 遠ざかるに従い減少するものと考えられる. これは逆の視 点で検討すれば、(0,0)次モードにおける Pe と Pem が相対的 に高値になったことを裏付けるものである.

4. 結 言

本研究では円板表面に圧電素子を貼付した振動発電シス テムを取り上げ,貼付位置を移行させたときの発電特性を 軸対称の(0,0)次モードと非軸対称の(1,0)次の振動モードの 比較から検討した.その結果,以下のことを明らかにできた. (1)各振動モードにおける円板の固有周波数は,最大(極大) 振幅が生じる箇所に圧電素子を貼付することでそれぞれの 最低周波数に至り,圧電素子を支持部方向に移行すること によって貼付による影響は徐々に弱められる.この変動幅 は,(0,0)次モードが(1,0)次モードを大きく上回る.

(2) 半径及び円周方向の面内ひずみ成分は面外変位と類 似の分布を呈し,(0,0)次モードの両成分は円板中心付近に おいてほぼ同値で最大化される.しかし(1,0)次モードにおけ る円周方向成分の最大値は面外変位と同じ位置で生じるが, その大きさは半径方向成分を下回り,さらに両成分共に(0,0) 次モードに比べて抑制されることになる.

(3) 発電特性は上記ひずみ特性に依存することから, (0,0)次モードにおける電力と効率は圧電部が円板中心か ら逸脱するまで高値のまま維持される.一方,(1,0)次モ ードにおける発電効率は円周方向の最大ひずみが生じる 個所付近で増大するが,それらの大きさは(0,0)次モード に比べて極めて小さく抑えられることになる.

参考文献

- H. A. Sodano, G. Park and D. J. Inman : Estimation of electric charge output for piezoelectric energy harvesting, Strain Journal, Vol.40, No.2, pp.49-58(2004).
- 藤本滋,今井健嗣,一木正聡:圧電素子を用いた振 動発電手法に関する研究(第2報,圧電素子の積層 化による発電特性の向上),設計工学,Vol.51, No.7, pp.497-508(2016).
- 藤本滋, 今井健嗣, 一木正聡: 圧電素子を用いた振 動発電手法に関する研究(第3報, 積層圧電素子の 最適積層数の検討), 設計工学, Vol.52, No.9, pp.567-582(2017).

- 安達和彦,田中亨:機械共振式の圧電振動発電に関 する基礎研究,日本機械学会論文集 C 編, Vol.76, No.761, pp.28-35(2010).
- 5) 安達和彦,坂本達哉:圧電コンポジットを用いた振 動発電装置のエネルギー変換効率に関する研究(シ ステムのエネルギーバランスと発電効率の評価),日 本機械学会論文集 C 編, Vol.78 No.789, pp.1575-

1585(2012).

 H. Moriyama, H. Tsuchiya, H. T. Uchida : E Effect of Acoustic Radiation from Circular Plate Installed with Piezoelectric Element on Electricity Generation Performance, Strain Journal, Applied Acoustics, Vol.186, pp.1-12(2022).

Profit Sharing 法を用いた追跡問題における 視野領域を考慮した学習方法の提案 ^{澤田 志門*1}奥山 淳*2

Proposal of a Profit Sharing Method for the Pursuit Problem Considering Field of View

by

Shimon SAWADA^{*1} and Atsushi OKUYAMA^{*2} (Received on Mar. 31, 2023 and accepted on May. 25, 2023)

Abstract

Multi-agent reinforcement learning (MARL) has received considerable attention in recent years. MARL has often been applied to the pursuit problem, in which multiple hunters try to catch single or multiple prey. In this problem, hunters are usually considered to have an infinite range of field of view (FoV) to obtain the absolute or relative positions of the prey as the hunters' states. However, this is inappropriate owing to "the curse of dimensions" and the range of FoV should be restricted suitably. On the other hand, strict restrictions on the range of FoV would prevent hunters from observing their states and continuing learning because they cannot obtain the prey's position when it is outside their FoV. Therefore, in this study, numerical simulations were performed to: (1) propose a method to continue to learn when the prey is outside the hunter's FoV, and (2) evaluate the appropriate restriction of the range of FoV for a size of field. The simulation results validated the effectiveness of the proposed method and revealed the relationships between the range of the hunter's FoV and the size of the field.

Keywords: Multi agent system, Reinforcement learning, Profit sharing, Pursuit problem

1. 緒言

近年,マルチエージェントシステム (MAS: Multi Agent System) に関する研究が広く行われている. MAS は複数 の自律的に行動する主体 (エージェント) が協調して動 作することで目標の達成を試みるもので,作業効率や耐 故障性やコストパフォーマンスに優れるとされている¹⁾.

この MAS の中でも特に, MAS へ強化学習を適用して その有効性を検証するマルチエージェント強化学習 (MARL: Multi Agent Reinforcement Learning)^{2,3)}の検討が 活発である. 例えば荒井らは追跡問題 (Pursuit Problem) に対して Q 学習と Profit Sharing 法 (以下, PS) を適用 し, MARL においては PS の方が有効であることを示し た⁴⁾. ここで,追跡問題は MAS における典型的な例題の 1 つであり, 2 次元のセル空間上を移動する複数のハン ターエージェント (以下, ハンター) および複数もしく は単数の獲物エージェント (以下,獲物)を対象とする. また, ハンターが獲物を捕獲することを目的とし, MARL ではその捕獲戦略の学習を試みる.

ただし、従来は学習に用いる状態を明言せず、暗黙の 了解として絶対座標系に基づいた獲物やハンターの位置

*2 工学部精密工学科教授

座標を状態とすることが多い⁴⁻⁸⁾.他方,状態として任意 のハンターを基準とした相対座標系における,獲物や他 のハンターとの相対位置を採用する検討もいくつか存在 する⁹⁻¹⁴⁾が,これらはどれもハンターが無限大の視野領 域を持っており,自分からみた他のハンターおよび獲物 との相対位置がわかることを条件としている.しかし, このように無限大の広さの視野領域をもつことは実ロボ ットへの適用を考えると適切ではなく,また RL および MARL の課題の1つである次元の呪いを生じうる.この ことからハンターの視野領域を適切に制限する必要があ るが,過剰に制限すると状態の取得が行えず,学習へ悪 影響を及ぼす可能性もある.このため,フィールドの大 きさに応じて適切な視野領域を設計する必要があるが, そのような検討は少ない.

また,視野領域を制限した場合には獲物が視野領域外 に存在することがあるが,その場合ハンターは自身と獲 物との相対座標を取得できず,学習における「状態」を 取得することができない.この場合学習を継続すること ができなくなるため,視野領域外に存在する獲物も「状 態」として考慮することが必要になる.しかし,そのよ うな手法についての検討は筆者の知る限り存在しない.

そこで本研究は限られた視野領域を持つハンターによ る追跡問題を題材とする.また追跡問題においては,視

^{*1} 総合理工学研究科総合理工学専攻博士課程

野領域内の獲物の相対座標を状態として用いた PS によ る捕獲戦略の学習を試みる.加えて,獲物が視野領域外 にいても学習を行えるような手法を2通り提案し,視野 領域の広さを変更したシミュレーション検討を行うこと で,フィールドの大きさと視野領域の広さの関係性およ び視野領域外の獲物の扱い方について考察する.

2. 強化学習

2.1 概要

強化学習は機械学習の1つであり、学習主体が試行錯 誤的に行動を繰り返すことで適切な行動を学習していく 手法である.なお、これ以降「強化学習によって学習を 行う、自律的に行動する主体」をエージェントとする.

ここで、本研究ではエージェントが観測できる状態の 集合をS、実行できる行動の集合をAとする.ただし、行 動の集合Aは状態の関数であるものとし、ある状態s \in S において実行できる行動の集合をA(s)とする.また離散 的な時間ステップを表す変数をt (t = 1,2,...)とし、時刻t における状態と行動をそれぞれs(t) \in S, $a(t) \in A(s(t))$ とする.ここで、エージェントは次の5つのステップを 繰り返すことで学習を行う: (1) エージェントは時刻t において、自身の状態s(t) = $s_i (s_i \in S)$ を環境から知覚す る. (2) エージェントは知覚した状態s_iを元に、自身の 方策 $\pi(s_i, a)$ から実行する行動 $a(t) = a_j (a_j \in A(s_i))$ を決 定する. (3) エージェントが(2)で決定した行動 a_j を行う ことで、環境が変化して状態がs(t+1)へ遷移する. (4) エージェントが環境から報酬R(t+1)を受け取る. (5) $t+1 \rightarrow t$ として (1) に戻る.

また,強化学習はQ学習などの環境同定型 (Exploration-oriented method)と,PSなどの経験強化型 (Exploitation-oriented method)に大別され、学習に要する 時間や必要な条件などに違いがある¹⁵⁾.ここで,Q学習 は特定の条件下では最終的に最適な政策が得られること が証明されているが、その条件として状態遷移がマルコ フ過程 (MDP: Markov Decision Process)であることを仮 定している.しかし、MARLでは複数のエージェントが 同時に行動を行うために状態遷移が MDP にならず、 MARL には適さない.

他方, PS は最終的に得られる政策が最適である保証が ないものの,状態遷移が MDP でなくても学習を行うこ とができる. 荒井らは追跡問題に Q 学習と PS をそれぞ れ適用し,学習結果の比較から MARL に対しては PS の 方が有効であることを示している⁴⁾. このことから MARL の検討では PS が多く用いられており,本研究で も PS を適用する.

最後に,強化学習の課題の1つに次元の呪いがある. これは状態数の爆発とも呼ばれ,状態数がきわめて多く なってしまうことによって学習が適切にできなくなると いう課題である. MARL でも,エージェント数の増加が 状態数の指数関数的な増加を引き起こしてしまうため, 課題の1つとされている^{2,3)}. ϕ ,エージェントが自身を 中心とした $m \times m \forall \forall a \in N$)を知覚できる場合,視野 領域の総マス数は m^2 となる.また視野領域内にいる他の エージェントを知覚して状態とする場合, エージェント の総数を $n (n \in \mathbb{N})$ とすれば状態の総数が $(m^2)^n = m^{2n}$ となる. ここで指数の肩にnがあるため, 状態の総数はエ ージェント数の増加に伴って指数関数的に増加してしま う. このことから, これを次元の呪いまたは状態数の爆 発と呼ぶ.

2.2 Profit Sharing 法(PS) ^{16,17)}

PS は経験強化型の強化学習手法の1つであり,状態と 行動に対する重みを更新することで行動の学習を行う. ここで,エージェントの状態sと行動aの組を併せてルー ルr = sāとし,学習を開始してから報酬を獲得するまで のルール系列をエピソードと呼ぶ.また,あるエピソー ドにおいて同一の状態に対して異なる行動が選択されて いるとき,その間のルール系列を迂回系列と呼ぶ.学習 を開始してから現在までのエピソードで常に迂回系列上 にあるルールを無効ルール,そうでないルールを有効ル ールと呼ぶ.このため,PS はルールに対する重みを強化 する学習法ともいえる.

時刻tにおける状態s(t)と行動a(t)によるルール $r(t) = \overline{s(t)a(t)}$ について、その重みを $w_{r(t)}$ とすると更新式は式(1)で表される.

$$w_{r(t)} = w_{r(t)} + f(t)$$
 (1)

ここで, *f*(*t*)は時刻*t*における強化関数の値である.この 強化関数によって重みを更新し,行動の学習を行う.

宮崎らは、無効ルールの学習を抑制するような強化関数の条件として合理性定理を提案している¹⁷⁾.式(2) に合理性定理を示す.1 エピソードにおけるステップ数の上限をWとし、時刻t = Wで報酬を獲得したとする.無効ルールを抑制して学習を行うには、時刻t = 1,2,...,Wにおいて強化関数f(t)が式(2)を満たせばよい.なお、各状態における有効ルールの最大個数をLとした.

$$L\sum_{\tau=t}^{W} f(\tau) < f(t-1)$$
⁽²⁾

この合理性定理を満たす強化関数として,式(3)が提案 されている¹⁷⁾.式(3)において $U \ge L + 1$ であり,本研究で は行動集合の要素数 $|\mathcal{A}|$ を用いて $U = |\mathcal{A}|$ とした.ここで 詳細は 3.1 節で述べるが,本研究ではすべての状態にお いてエージェントが最大で5つの行動を選択可能である. このためある状態sにおいて選択可能な行動の集合 $\mathcal{A}(s)$ について $|\mathcal{A}(s)| \le 5$ が成り立つが,式(3)においてはこの 最大値5を用いれば強化関数は式(2)を満たす.よって本 研究ではU = 5とした.また,Rは報酬値である.

$$f(t) = \begin{cases} R & (t = W) \\ \frac{1}{U} f(t+1) & (t = 1, 2, ..., W - 1) \end{cases}$$
(3)

また、本研究ではハンターがルーレット選択を用いて 行動を選択するものとする. 今、時刻tにおける状態 $s(t) = s_c$ において、エージェントが行動 $a(t) = a_k (a_k \in \mathcal{A}(s_c))$ を選択する方策 $\pi(s_c, a_k)$ は、ルール $r_{ck} = \overline{s_c a_k}$ に対 する重み w_{ck} を用いて式(4)で表される.なお w_{ch} はルール $r_{ch} = \overline{s_c a_h} (a_h \in \mathcal{A}(s_c))$ に対する重みである.

$$\pi(s_c, a_k) = \frac{w_{ck}}{\sum_{a_h \in \mathcal{A}(s_c)} w_{ch}}$$
(4)

3. 追跡問題

3.1 基本的な問題設定

追跡問題は MAS の基本的な例題の1 つであり,複数 のハンターによって単数もしくは複数の獲物を捕獲する ことを目的とする.本研究では従来研究 ⁴⁻¹⁴⁾を参考に, 以下の設定とする.

まず、フィールドはp×pマスのセル状であるとし、壁のないトーラス形状であるとする.ここで、p×pマスのフィールドの大きさをpで表す.さらに本研究では2台のハンターと1台の獲物が存在し、どちらも上下左右マスへの移動およびその場への静止という5つの行動を行えるものとする.ただしハンターと獲物はそれぞれ固有の視野領域をもつ.すべてのハンターと獲物は各エピソードの開始時に重複しないランダムなセルへ配置され、そこから1ステップごとに1つの行動を選んで一斉に実行するものとする.

また、本研究では獲物の上下左右マスのうち、いずれか2 マスに全ハンターが位置すれば捕獲を達成した、として全 ハンターへ等しい大きさの報酬を与える.

さらに、本研究ではフィールドがトーラス形状であるた め移動や視野領域に回り込みが生じる.Fig.1を用いてこれ の詳細を述べる.ここで、Fig.1はあるタイミングにおける ハンターおよび獲物の位置関係の一例である.Fig.1はフィ ールドの大きさがp=5であり、獲物を四角形、ハンターを 三角形およびひし形で表している.また、Fig.1ではハンタ ーの視野領域を3×3としており、塗りつぶしたマスがハン ター1の視野領域を表している.このとき、フィールド形状 からハンター1の視野領域は下方が反対側へ回り込むよう になる.また詳細は後述するが、獲物はこのとき上下左マス への移動または静止の4つからランダムに行動を選択する. もし左または下へ移動する場合、獲物はその反対側である 黒い星型のあるマスへ回り込むように移動を行う.





3.2 獲物の詳細な定義

獲物は自分を中心とした3×3マスの視野領域をもち, 視野領域内のハンターから逃避的な行動を取るものとす る.例えば Fig. 1 の場合,獲物はハンター1 と重なるこ とを避けるため,右マスを除いた残りの上・下・左マス への移動およびその場での静止という4つの行動から等 確率に行動を選択する.なお,視野領域内にハンターが 存在しない場合は移動するマスへの制限がないため,上 下左右マスへの移動および静止という5つの行動から1 つを等確率で選択する.

3.3 ハンターの詳細な定義

ハンターは自分を中心としたq×qマスの視野領域を もち、その中にいる獲物および他のハンターの相対位置 を知覚できる.また、自身を基準にした獲物の相対位置 を学習における状態として用いる.ここで、q×qマスの 視野領域の広さをqで表す. Fig.1の場合はq=3であり、 ハンター1は自身の左マスに獲物が、上マスにハンター2 がいることを知覚できる.またハンター2 は自身の左下 マスに獲物が、下マスにハンター1 がいることを知覚で きる.

ここで、各ハンターは獲物のいるマスへの移動を行わ ないため、獲物と重複しないマスのみを候補とし、方策 に従って行動を選択する. これの詳細を Fig. 1 のハンタ -1を例として述べる. 今, ハンター1の上下左右マスへ の移動および静止の行動を順に $a_{II}, a_{D}, a_{L}, a_{R}, a_{S}$ とし, ハン ター1 を基準にした獲物の相対位置を学習における状態 とする.このとき獲物がハンター1の1マス左に位置し ているため,状態をs_Lで表すこととする.またs_Lにおける ルール $r_h = \overline{s_L a_h} (h = U, D, L, R, S)$ に対する重みを w_h とす る. このときハンター1 は左マスに移動すると獲物と重 なってしまうため,残りの $a_{II}, a_{D}, a_{R}, a_{S}$ のうちから行動を 選択する. つまり, 状態s_Lにおいて実行可能な行動の集 合は $\mathcal{A}(s_L) = \{a_{II}, a_D, a_R, a_S\}$ となる. このときハンターは 式(4)に示すルーレット選択によって行動を選択するた め、例えば上マスへの移動である行動auを選択する確率 $\pi(s_{I}, a_{II})$ は次式で求められる.ここで実行できない行動 a_L は集合 $\mathcal{A}(s_L)$ に含まれておらず、その重み w_L は行動選 択に用いないことに注意が必要である.

$$\pi(s_L, a_U) = \frac{w_U}{w_U + w_D + w_R + w_S}$$

ただし,ハンター2 においては獲物が自身の上下左右 には存在しないため,上下左右マスへの移動および静止 の5つから方策にのっとって行動を選択する.一方,も し獲物が上への移動,ハンター2 が左への移動を選択す ると同じマスへ移動することになる.このとき,本研究 ではこのような場合の例外処理は行わない.つまり,ハ ンター2 と獲物は重複するマスへ移動するが,その後獲 物は静止以外の4つから行動を選択し,ハンター2 は獲 物が同じマスにいるという状態を認識するものとする. これは, Fig. 1 においてハンターの視野領域は3×3であ るため合計9マスが認識できる一方,ハンター・獲物の 行動は上下左右および静止の5つであり,視野領域のうち斜めの4方向はハンター・獲物の行動を制限しないためである.

なお、獲物と重複するマスへの移動については従来研 究でも「重複したマスへ移動しようとした場合はその場 で静止させる」とするものがある.しかしその場合は本 来ハンターが選択した行動を実行させておらず、必要以 上に静止行動の重みが強化されてしまい学習に悪影響を 与えると考えた.そこで、本研究ではハンターが初めか ら獲物と重なるマスへは移動せず、獲物と重複しないよ うに行動する中で学習を行うものと定義した.

3.4 従来研究での追跡問題における課題

本研究では,追跡問題における視野領域の広さに注目 する.1章および 3.1節でも述べたように,追跡問題は MAS における典型的な問題の1つであり,MARLの研 究でも広く用いられている.しかし,MARLの従来研究 の多くはハンターが無限大の広さの視野領域をもってお り,他のハンターや獲物の位置を常に正確に把握するこ とができるとしている.これは,視野領域に制限を設け た場合ハンターが視野領域外にいる獲物を認識できず, 学習する際に「状態」が不明になってしまうためである. したがって,従来研究の学習方式では獲物が視野領域外 になった瞬間から学習を継続することができなくなる.

これの解消を図るため、本研究では獲物が視野領域外 に存在する場合にもハンターが学習を継続できる手法を 提案する.

4. 提案手法

4.1 概要

本研究では、獲物がハンターの視野領域外にいる場合 にも、ハンターが学習を継続できる手法を提案する.獲 物がハンターの視野領域外に存在する場合、ハンターの 視野領域内には獲物がいなくなるため、ハンターは自身 からみた獲物の相対位置を取得することができない.

このため、本研究では視野領域をいくつかに分割し、 視野領域外の獲物はその分割した領域のいずれかにいる ものとして扱う.この視野領域を分割した領域を写像領 域と呼び、「視野領域外に存在する獲物がいずれかの写像 領域へいるものとして扱う」ことを「獲物の位置を任意 の写像領域へ写像する」と表現する.

しかし,視野領域の分割方法には自由度が存在するため,本研究ではこの分割方法を2つ提案し,効果的な学習を行うことができる分割方法についてシミュレーション検討の結果から考察する.

4.2 提案手法1

提案手法1は、写像領域として視野領域の外周部のみ を分割したものを用いる手法である.詳細をFig.2に示 す.Fig.2ではフィールドの大きさをp=7,視野領域の 広さをq=5とし、ハンターを三角形で示している.また、 写像領域を分割ごとに塗りつぶし、対応する番号を振っ てある.本手法では視野領域の外周部のみ上下左右と斜 めの8領域に分割して写像領域を定義している.このとき,詳細は4.4節で述べるが各写像領域を構成する視野 領域内のマス全てに対してルール重みの強化が行われる.

本研究では式(3)で定義される強化関数によってルー ル重みの強化を行うが、その値は学習開始直後のステッ プが最も小さく、報酬を獲得したステップで最も大きい. このとき視野領域の外周部分はハンターから(q-1)/2マ スだけ離れているため、「最後に獲物が外周部分にいたス テップ数」は視野領域広さqが大きくなるほど「報酬獲得 ステップ」から遠ざかる.このため視野領域の外周部分 のルール重みを強化する強化関数の値はqが大きくなる につれて小さくなるため、本手法によって視野領域の外 周部分を多く強化すれば効果的な学習が実現できると考 えた.なお、この分割方法は渡邊ら¹³)における視野の制 限方法を参考に決定した.



Fig. 2 Correspondence between Mapping area and hunter's FoV in proposal method 1.

4.3 提案手法 2

提案手法2は写像領域として視野領域内を十字に分割 したものを用いる手法である.この詳細を Fig.3 に示す. Fig.2 と同様にp=7, q=5とし,ハンターを三角形で示 した.また Fig.2 と同様,写像領域を分割ごとに塗りつ ぶし,番号を振っている.Fig.3 のようにハンターの上下 左右マスおよびそれ以外の8つに視野領域を分割し,写 像領域としてこの8領域を用いる.このとき,詳細は4.4 節で述べるが提案手法1に比べて視野領域内のより多く のマスを強化できるため,視野領域内に獲物が存在する 場合に適切な行動を選択することができ,学習に良い影 響を及ぼすと考えた.なお,この分割方法は伊藤ら ⁹お よび片山ら¹²)を参考に決定した.



Fig. 3 Correspondence between Mapping area and hunter's FoV in proposal method 2.

4.4 提案手法の適用方法

本研究では2つの提案手法で視野領域を分割し,写像

領域のいずれかに視野外の獲物が存在するものとして推 定(写像)する.ただし、どの領域へ写像されるかはラ ンダムに決定し、それぞれの領域へ等確率に、12.5%の確 率で写像されるものとする.

加えて,各領域を選択した場合に学習をどのように行 うか述べる. 今, Fig. 4 のようにハンター・獲物が存在 し、ハンターは提案手法 2 を用いるとする. またp=7, q=5であり、ハンター・獲物をそれぞれ三角形・四角形 で示した. さらに, ハンターは視野領域内にいる獲物の 相対的な位置を学習の状態として用いるが、ハンターが 認識する相対位置と「状態」の番号を対応付けて Fig. 4 に示した. 例えば獲物がハンターの右方1マス, 上方2 マスに存在した場合, Fig. 4 よりハンターの状態は状態 15 となる. ハンターと獲物が Fig.4 の位置関係にあると き,獲物はハンターの視野領域外に存在するため,状態 の番号は取得できない. そこで写像領域を1つランダム に選択するが、ここでは赤い線で囲った写像領域1が選 ばれたものとする. このとき, 写像領域1はFig.3,4よ り状態1,2,6,7から構成されているため,式(1)を用い た重みの更新をこの4状態に対して行う.ここで、この ように視野領域外に獲物がいる場合は各領域を構成する すべてのマスに対して重みの更新を行うのに対し、視野 領域内に獲物がいる場合は獲物が位置するマスが正確に 取得できるため、その特定のマスに対して重みの更新を 行うことに注意が必要である.

			Hur	nter 🗖	Prey
1	6	11	15	20	
2	7	12	16	21	
3	8		17	22	
4	9	13	18	23	
5	10	14	19	24	

Fig. 4 An example of how to reinforce a Hunter.

続いて,提案手法におけるハンターの行動選択手法に ついて述べる.ハンターは式(4)に示すルーレット選択に よって行動を選択するが,獲物が視野領域内にいる場合 は獲物の位置するマスが正確にわかる. したがってその マスにおけるルール重みの値から式(4)を用いて行動を 選択する.他方,獲物が視野領域外にいる場合は前述の ように写像領域がランダムに選択されるため,「獲物の位 置するマスのルール重み」を用いることができない.こ のとき, ハンターは写像領域を構成するマスのルール重 みを平均した値を用いて式(4)からルーレット選択を行 い,行動を選択する. 例えば Fig. 4 における写像領域1 が選択された場合,写像領域1は状態1,2,6,7から構 成されるためこれらの状態におけるルール重みの値を平 均し,その平均値を用いてルーレット選択から行動を選 択する.

最後に,視野領域の大きさの制限について述べる.本 研究では Fig. 2, 3 のように視野領域の分割方法を 2 つ提 案するが,視野領域の広さqはq≥5とする.これはFig.5 のように、q=3であるときは視野領域が2つの提案手法 で同じように分割されてしまうためである.なお, Fig.5 lp = 5かつq = 3とし、ハンターを三角形で示した.



Fig. 5 Divided hunter's FoV area when q = 3.

5. シミュレーション条件と結果および考察

5.1 シミュレーションの環境と条件

本研究では数値計算用ソフトウェアである MATLAB 2022a を用い, p = 11のフィールドを対象としてシミュレ ーション検討を行った. 各シミュレーションにおけるパ ラメータを Table 1 に示す. Table 1 より報酬値は 1000 で あり,これは獲物の捕獲達成時に各ハンターへ与えられ る値である.またこの値を用いて式(3)から強化関数の値 が導出され,式(1)によってルール重みの強化が行われる.

Table 1 Lear	ning conditions.
Field size	11 × 11
Size of hunter's FoV	5, 7, 9, 11
Number of episodes	3.0×10^{5}
Maximum number of steps	100
in each episode	100
Reward value	1.0×10^{3}
Initial value of rule weight	200

5.2 学習の継続性からみた提案手法の有効性の検証

本節では獲物がハンターの視野範囲外に出てしまうエ ピソード数およびステップ数について述べる. 3.4 節で も述べたように、従来手法ではハンターが獲物の視野領 域外に出てしまうとハンターは状態を取得できず,学習 を継続できない.このため、本研究ではそうした状況で も学習を継続できるような手法を提案する. 学習の継続 性という観点から提案手法の有効性を検証するため、学 習の中で獲物がハンターの視野範囲外に出てしまうエピ ソード数およびステップ数を調べた.

ここで、本研究ではハンター・獲物の初期位置や行動 選択などにランダム性が関係するが、このランダム性は 乱数の種によって制御される. そこで、本研究ではこの 乱数の種を6つ設定し、それぞれにおいて視野領域の広 さをq = 5,7,9,11と変化させて追跡問題の学習を試みる.

各乱数の種を用いた追跡問題において、視野領域の広 さをq=5,7,9としたとき、獲物がいずれかのハンターの 視野領域外に出たエピソード数とステップ数を Table 2 に示す.なお、Table2では各乱数の種および視野領域の 広さqに対して,視野領域外に出たエピソード数n_{Episode},

ステップ数 $n_{step} e(n_{Episode}, n_{step})$ として示した.例とし て、Table 2 において 1 番目の乱数の種に対して視野領域 の広さqがq = 9であるとき、値が(2,1)となっている. これは、この条件では 2 エピソード目の 1 ステップ目に 獲物がいずれかのハンターの視野領域外に出てしまうこ とを意味する.なお、1 エピソード目の 1 ステップ目で 視野領域外に出ていない表の項目を薄く塗りつぶしてあ る.また、Table 2 に示した各乱数の種の値は筆者が任意 に定めた.

Table 2 Number of episodes and steps when the prey is outside of the field of view of any Hunters.

Number	Value	q = 5	q = 7	q = 9
1	1109	(1,1)	(1,1)	(2,1)
2	31	(1,1)	(1,1)	(1,5)
3	323	(1,1)	(1,1)	(1,1)
4	11	(1,1)	(1,1)	(1,1)
5	9	(1,1)	(1,1)	(1,1)
6	1205	(1,1)	(1,1)	(1,1)

Table 2 より, すべての乱数の種においてq = 5,7の場合 は1エピソード目の1ステップ目に獲物がいずれかのハ ンターの視野領域外に位置していることがわかる.特に 3・4・5・6 番目の乱数の種ではq = 9の場合にも同様で あり, 1・2 番目の乱数の種もそれぞれ2エピソード目 の1ステップ目,1エピソード目の5ステップ目に獲物 が視野領域外に位置している.

つまり、すべての乱数の種において少なくとも2エピ ソード目以降はハンターが学習における状態を取得でき ないため、従来手法を用いた場合に捕獲戦略の学習がで きなくなることがわかる.他方、提案手法を用いればこ うして視野領域外に出た獲物についても学習に用いるこ とが可能であるため、Table 1 に示した全 30 万エピソー ドによる学習が可能である.

5.3 シミュレーション結果・考察

次に,提案手法による学習性能についての検討を行う. 結果を述べる前に,まず本研究では 3.1 節および 5.2 節 でも述べたようにエピソードごとに獲物・ハンターの初 期位置がランダムに設定される.このため,エピソード によっては初期位置の影響で捕獲が容易または困難にな ることがある.このような初期位置への依存性をなくす ため,全 30 万エピソードを 1000 エピソードごとに分割 し,その分割ごとに捕獲までのステップ数の平均を取っ た.以降,1000 エピソードごとに平均を取った,1エピ ソードにおける捕獲までのステップ数を単に「捕獲ステ ップ数」と呼ぶ.

ここで, Fig.6(a)~(f)はそれぞれ 1~6 番目の乱数の種 を用いて追跡問題の学習を行った際の,各視野領域の広 さ・提案手法における捕獲ステップ数の推移である.そ れぞれ横軸がエピソード数(×1000),縦軸が捕獲ステッ プ数を表す.また,各図の凡例として,視野領域の広さ qの値と共に提案手法1を用いたものをA,提案手法2を 用いたものを*C*とした. 例えば Fig. 6 (a) の中央に存在す る紫色で三角形のマーカーを付けたものは凡例がq = 7Cとなっているが、これは視野領域の広さをq = 7として、 提案手法 2 を用いた時の結果であることを意味している. なお、q = pであるときはフィールドを完全に知覚でき、 提案手法の影響を受けないため、単にq = pとした.



Fig. 6 Number of averaged captured steps in each FoV.





Fig. 6 より、いずれの乱数の種を用いた場合も視野領 域の広さqがフィールドの大きさpに等しいとき, 捕獲ス テップ数が小さい値に収束していることが確認できる. また、この収束値は約17ステップであり、学習を始めた ばかりの約 40~45 ステップよりも少ないステップ数で 捕獲が達成できている. ただし Fig. 6 (d)より, 乱数の種 によっては最小値には収束していない. この原因の1つ として、学習エピソードの数が不足していることが考え られる. Fig. 6(d)において, q = 9A, q = 9Cの値はどちら も約 150(×1000)エピソード以降でそれぞれおよそ 19, 17 ステップに収束している.他方, q = 11の値は 150(× 1000)エピソード以降も緩やかな減少を続けており、 300(×1000)エピソードにおける値が約 17 ステップにな っている.ここでq=9の場合は視野領域を構成するマス 数が $q^2 = 81$ マスである一方, q = 11の場合は $q^2 = 121$ マ スとなる.つまり、q=11の場合は視野領域を構成する マス数がq = 9の場合より 40 マスだけ多いため、q = 9の 場合より多くのマスに対してルール重みの学習を行う必 要がある.このことから学習にはより多くのエピソード 数が必要であり、 q=9のときは本研究で定めた全30万 エピソードで学習が収束する一方, q=11のときはエピ ソード数が不足していたと考えられる.

なお、本研究では Table 1 に示したように全 30 万エピ ソードで学習を行ったが、この 30 万という値は筆者が 試行錯誤的に決定したものである. Fig. 6 (b) より、q = 11の場合の値は 200(×1000)エピソードで値が収束して いるものの、q = 9A,9Cの場合は約 150(×1000)エピソー ドで値が収束している.また、荒井らの検討では全 10 万 エピソードでの学習を行っており⁴⁾.これらの点を考慮 して本研究ではエピソード数を30万とした.

続いて,q<pの場合はq=9,7,5の順に捕獲ステップ数 が小さい値へ収束していることがわかる.まずq=9の場 合,いずれの乱数の種を用いた場合も提案手法1・2の両 方で捕獲ステップ数がq=pの場合の収束値と近い値に 収束していることがわかる.また、3・4番目の乱数の種 を用いた場合はそれぞれ提案手法 1・2 を用いた方がよ り小さい捕獲ステップ数に収束している.ただしその差 は約3ステップほどであり、またこれ以外の1・2・5・6 番目の乱数の種を用いた場合はほとんど収束値に差がな い、このことから、両提案手法で捕獲ステップ数の収束 値に大きな差はないと考えられる. なお, 捕獲ステップ 数の値の推移に着目すると、2・4・6 番目の乱数の種を 用いた場合は提案手法2が、1番目の乱数の種を用いた 場合は提案手法 1・2 の両方がq = pの場合より早く値が 収束している.このことから,視野領域の広さがq=9の 場合は提案手法2を用いることで比較的早く学習が収束 するものの,学習性能に大きな差はなく,両手法ともq= pの場合に近い学習性能を持っているといえる.

続いてq=7の場合,両提案手法とも捕獲ステップ数が 約25~28ステップ程度に収束しており,2・4・6番目の 乱数の種を用いた場合はほとんど同じ値に収束している ことがわかる.また1・5番目の乱数の種を用いた場合は 提案手法2を,3番目の乱数の種を用いた場合は提案手 法1を用いた方がより少ないステップ数に収束している. このことから,q=7の場合もq=9の場合と同様に両提 案手法で学習性能に大きな差はないと考えられる.

ここでq = 5の場合を考えると,まずq = p,9,7の場合 は捕獲ステップ数が学習初期は約 40~45 ステップとな っており、学習によってそこから約 20 ステップまたは 約 30 ステップに収束している.一方q = 5の場合、学習 初期は捕獲ステップ数が約 50 ステップとなっており、 そこから 40~45 ステップの値に収束していることがわ かる.特に 3・4 番目の乱数の種を用いた場合は収束値が ほとんど変化していないため、q = 5の場合学習そのもの は行えるものの、学習性能は低いと考えられる.

最後に,視野領域の広さについて考察する. 今回のシ ミュレーション検討では対象とするフィールドの大きさ をp=11としたが、この場合フィールドの総マス数は 11² = 121マスである.他方,視野領域を構成するマス数 はその広さgを用いてg²で求めることができる.ここで, フィールドの総マス数に対して視野領域が占めるマス数 の割合を、視野領域の広さqの関数としてH(q)で定義す る.このとき、フィールドの大きさpがp = 11であるため $H(q) = q^2/121$ であり, q = 5,7,9とした場合の値を Table 3にまとめる.このとき、q=5の場合は学習の性能が低 く, q = 7以上であれば性能に差はあれ学習が行えるため, フィールドの大きさに対しておよそ40%の領域が知覚で きるとき,提案手法によって学習が行えると考えられる. また,視野領域の広さがq=9であるとき,すなわち約 66%が知覚できれば、提案手法によってフィールド全域 が知覚できる場合と同等の学習性能を発揮できると考え られる.

Table 3 Ratio of each field of view to the field.

q	5	7	9
q^2	25	49	81
H(q)	0.2066	0.4049	0.6694

6. 結言

本研究では、視野領域を制限したハンターによる追跡 問題に対して、視野領域外に存在する獲物を学習に用い るための手法について検討を行った.従来手法では獲物 が視野領域外に存在することがないように無限大の広さ の視野領域を持つことがほとんどであるが、視野領域外 の獲物の位置を「写像領域」のいずれかへ写像し、その 写像した状態を学習に用いることで視野領域外に獲物が 存在するときでも追跡問題の学習が行えることをシミュ レーション検討によって示した.

シミュレーション検討においては11×11のフィール ドを対象とし、複数の乱数の種を用いて追跡問題の学習 を行い、その学習性能の評価を行った.まず学習の継続 性から考えると、従来手法では少なくとも2エピソード 目までにいずれかのハンターの視野領域外に獲物が存在 してしまい、学習が継続できなくなるのに対して、提案 手法ではその視野領域外の獲物に対しても学習が行える ことを示した.次に、フィールド全域が認識できている ときが最も捕獲までのステップ数は少ない値に収束する ものの,視野領域が9×9であれば,提案手法を用いるこ とでフィールド全域が知覚できている場合とほぼ同じ捕 獲ステップ数へ収束することが分かった.また,5×5の 視野領域しか認識できない場合も性能は劣るものの、学 習によって捕獲ステップ数が小さい値へ収束することが 分かった. 加えて, 提案手法を用いれば少なくともフィ ールドの 40%程度が知覚できれば学習を行うことがで き、また66%程度が知覚できればフィールド全体が知覚 できる場合と同等の学習性能を示すことが示された.

今後の展望として,現在は獲物の相対位置のみを状態 として用いているが,例えば他のハンターの状態を加味 しての学習や,情報通信を考慮した学習などを行い,ハ ンター間の協調の創発を試みる.また,フィールドをさ らに大きくした上でのハンター・獲物の台数の増加,連 続時間系への理論の拡張などを行う予定である.

参考文献

- 橘義博, 森翔平 and 滑川徹: 外乱を考慮したマルチ エージェントシステムの協調制御, 計測自動制御学 会論文集, Vol.50, No.9, pp. 669-676 (2014).
- L. Canese, G. C. Cardarilli, L. D. Nunzio, R. Fazzolari, D. Giardino, M. Re and S. Spanò: Multi-Agent Reinforcement Learning: A Review of Challenges and Applications, Applied Sciences, Vol.11, No.11, p.4948 (2021).
- 3) 荒井幸代:マルチエージェント強化学習:実用化に 向けての課題・理論・諸技術との融合、人工知能学会 誌, Vol.16, No.4, pp.476-481 (2001).

- 第井幸代,宮崎和光 and 小林重信:マルチエージェント強化学習の方法論:Q-Learning と Profit Sharing による接近,人工知能学会誌, Vol.13, No.5, pp.609-618 (1998).
- 5) 伊木美太輔, 松本啓之亮 and 森直樹: 追跡問題にお ける状態数とメモリ量の削減に着目した Q 学習, シ ステム情報学会論文誌, Vol.25, No.10, pp.266-271 (2012).
- 6) 安田真,古橋武,橋山智訓 and 大熊繁: マルチエー ジェント系のポテンシャル関数による制御と強化学 習の適用に関する検討,計測自動制御学会論文集, Vol.36, No.8, pp.698-706 (2000).
- 7) 保知良暢,松井藤五郎,犬塚信博 and 世木博久:マルチエージェント強化学習における報酬発生条件に 基づく貢献度判別と報酬分配,人工知能学会全国大 会論文集, Vol.JSAI02, p.129 (2002).
- 宮崎和光, 荒井幸代 and 小林重信: Profit Sharing を 用いたマルチエージェント強化学習における報酬分 配についての理論的考察,人工知能学会誌, Vol.14, No.6, pp.1156-1164 (1999).
- 9) 伊藤僚,吉川毅 and 野中秀俊:マルチエージェント 強化学習における知覚情報の適応的粗視化,日本知 能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジ ウム 講演論文集, Vol.26, p.18 (2010).
- 10) 長行康男 and 伊藤実: マルコフゲームにおける環 境モデルの推定を利用したマルチエージェント強化 学習法,情報処理学会研究報告知能と複雑系, Vol.2001, No.73(2001-ICS-125), pp.29-36 (2001).
- 長谷川雄吾,高田沙都子,中野秀洋,荒井秀一 and 宮内新:行動選択確率に基づく動的強化関数を用い た強化学習手法,信学論,J.89-D-I, No.4, pp.788–796 (2006).
- 片山謙吾, 輿石尚宏 and 成久洋久:強化学習エージェントへの階層化意志決定法の導入--追跡問題を 例に--, Vol.19, No.4, pp.279-291 (2003).
- 13) 渡邊俊彦 and 和田竜也: マルチエージェント追跡 問題のための相対座標系に基づく階層型モジュラー 強化学習,バイオメディカル・ファジィ・システム学 会誌, Vol.12, No.2, pp.65-74 (2010).
- 玉城斉,遠藤聡志 and 山田孝治: Q-learning を用い たマルチエージェントにおける協調行動獲得に関す る研究,琉球大学工学部紀要, No.54, pp.101-108 (1997).
- 15) 山村雅幸, 宮崎和光, 小林重信: エージェントの学 習, 人工知能学会誌, Vol.10, No.5, pp.23-29 (1995).
- 16) 玉嶋大輔,小圷成一,岡本卓 and 平田廣則:期待 強化値を考慮した動的強化関数を用いる Profit Sharing,電気学会論文誌 C (電子・情報・システム部 門誌), Vol.129, No.7, pp.1339-1347 (2009).
- 17) 宮崎和光,山村雅幸,小林重信:強化学習における 報酬割当ての理論的考察,人工知能学会誌,Vol.9, No.4, pp.580-587 (1994).

音声波形の時間微細構造から見たアクリル板設置による聞き分け

低下の要因とその簡易改善法

山本 亜優*1 八坂 由衣*1 堀越 哲郎*2

Undesirable Effect of Acrylic Partitions on Speech Recognition and a Simple Improvement Method Estimated by the Temporal Fine Structure of Speech Sound Waveforms

by

Ayu YAMAMOTO^{*1}, Yui YASAKA^{*1} and Tetsuro HORIKOSHI^{*2} (Received on Mar. 29, 2023 and accepted on May 25, 2023)

Abstract

In this study, the phenomenon of acrylic partitions affecting speech waveforms and making them difficult to hear was evaluated by observing speech waveforms from the perspective of the temporal fine structure. The results revealed a strong tendency for the waveform features of voiceless and voiced burst consonants and affricative consonants to be obscured by an acrylic partition. In order to reduce this negative effect on speech recognition, we tested whether the waveforms of these consonants could be restored by forming a small window in the acrylic partition and attaching a splash-proof PVDC film to it. As a result, the waveforms of these consonants were partially but effectively restored. The methods used in this study are simple and inexpensive, yet effective.

Keywords: Speech sound waveform, Consonant recognition, Temporal fine structure, Acrylic partition

1. まえがき

2019 年より世界にパンデミックを引き起こした新型 コロナウイルス感染症(COVID-19)は、日本において 2023 年3月現在も完全には収束していない. その感染対策の ひとつとして、対面での会話の際にアクリル板のパーテ ィションを対話者の間に置き、お互いの飛沫を直接浴び ないように努める場面も多い.アクリル板はガラス板と 同程度の透明度を持ち視覚情報を遮らないこと、比較し て軽いために設置しやすいこと、割れた場合での安全性 も比較的高いことなどから対面会話時のパーティション として多く導入されている.一方,アクリル板があるこ とによって音声が聞き取りにくくなることも報告されて おり¹⁾, それを補うためにマイクとスピーカーをアクリ ル板両側に設置する装置も市販されている. このような 付加装置はアクリル板の設置に加えての費用や電源の確 保が必要となり、教育現場のような場で多数導入するこ とは難しい. そこで本研究では、アクリルパーティショ ンを介した音声の聞き取りにくさを音声波形の観察で評 価する簡易的な方法を用い、アクリル板に簡単な工作を 施すことで聞き取りを改善できるか検討した.

アクリル板が音声伝達を妨げる原因として次の事が考

*1 工学部医用生体工学科学部生

*2 工学部医工学科教授

えられる.(1)空気とアクリル樹脂では音響インピーダン スが大きく異なるため、音エネルギーの多くはアクリル 板表面で反射されてしまう.具体的に反射率を推定する と空気の音響インピーダンスはおよそ 4×10² kg/m²·s で あり、アクリル樹脂の音響インピーダンスが 3.6×106 kg/m²・sという報告²⁾を基にすれば反射率99.98%となる. つまり、話者から直進的に発せられた音声のほとんどは アクリル板で反射されてしまい聴取者にはほぼ直接には 届かない.(2)そのため聴取者に届く音声のほとんどはア クリル板の縁を回折して届くものと机の天板や部屋の壁 や天井などで反響したものとなり、それらが聴取者の耳 元で干渉して合成された音となる.(3)音の回折の点から 見るとヒトの可聴域 20 Hz から 20 kHz の音は音速 340 m/s とすれば波長がおよそ 17 m から 17 mmとなる.特 に音声の聞き分けに重要とされる 300 Hz から 4kHz の周 波数帯域 3)に限っても 1.1 mから 85 mm となり、低音は 回折により到達しやすいが高音になるとアクリル板の陰 になる場所には到達しにくいことになる. 加えてアクリ ル板や室内での反射により様々な経路長を取った音が合 成されるため位相情報が乱されることになる. これらに より音声の聞き取りに重要とされる時間微細構造 4-7)の 乱れ,つまり本来必要な波形特徴量の減少が予想される.

これらの予想を特別な機材を使わずに実験的に確かめ ることとアクリル板の飛沫防止効果を保ったまま音声伝

達を改善することを目指して本研究では次の実験を行っ た. 通常の実験室内の実験机の上に設置したアクリル板 の有無によって, 到達する音声波形の時間微細構造がど の程度変化するのかをスピーカーで再生した音声をマイ クロフォンで記録することにより観察した.次にアクリ ル板のほぼ中央部に視認性を妨げない程度の開口部(窓) を設け、そこへ空気の流れを遮断しかつ音の透過を妨げ にくい薄いフィルムを貼ることで音声の時間微細構造が どの程度保たれるのか検討した.その結果,アクリル板 設置により音声波形の高周波成分の振幅と山谷数の減少 が見られ、それがアクリル板に開口部を設けることで一 定程度減少が抑えられること、そしてその開口部を厚さ 0.011 mm のポリ塩化ビニリデンフィルムで密閉しても 音声波形への影響は少ないことが確認された. この方法 を用いればコストをほとんどかけずに音声伝達に必要な 時間微細構造の状態を簡易評価できる. それに加え, 簡 単で安価な加工法によりアクリル板のパーティションと しての利点を保ちつつ音声伝達も改善できることが示さ れた.

2. 実験方法

通常の実験室内の実験机上に幅 800 mm 高さ 600 mm 厚さ5mmのアクリル板(Aurako製)を設置した.アク リルパーティションを介した人の会話を想定し、アクリ ル板を挟むようにして各々15 cm離した位置に USB スピ ーカー(サンワサプライ製, MM-SPU9BK)と全指向性 バックエレクトレットコンデンサー型モノラルマイクロ フォン(オーディオテクニカ製, AT9931PC)を設置した. 人の口と耳の位置に近くなるようにスピーカーの中心高 さは机上 27 cm, マイクの中心高さは 34 cm とした.ア クリル板に窓を設定する場合は、会話者同士の視認性を 損なわないことを考慮して眼の高さより下になるように した.具体的にはアクリル板の左右の中心かつ下端から 22.5 cm を中心とした幅 10 cm 高さ 5 cm の窓とした (Fig. 1). 窓に貼るフィルムとしてはポリ塩化ビニリデン 旭化成製,厚さ 0.011 mm)を使用した.なお,使用した PVDC フィルムは水や多くのガスを通さず自己接着性 (密着性)を持つ⁸⁻¹⁰⁾. アクリル板にも接着剤などを使 うことなく密着させることができた.

音声は PC (Dell 社 Dimension E520) に保存した NHK ラジオニュースの音声ファイル (サンプリング周波数 48 kHz 約 2.5 分間の MP3 ファイル)を再生することで行っ た.音の再生と録音は波形編集ソフト (Audacity® Ver. 2.0.5)を用い、一連の実験中にスピーカーの音量とマイ クのゲインは一定とした.実験室の空調は作動している が、周囲で会話はされていない条件で測定を行った.マ イクで録音された音データは波形編集ソフト(Audacity® Ver.3.2.5)を用いて波形表示し、そのうちの典型的であっ た部分を Sample Data Export 機能により数値データとし て書き出し、それを表計算ソフト (Microsoft 社、Excel)



Fig. 1 Photograph of experimental set up.

によりグラフ表示した.なお,録音した音データは一切 の加工をせずに波形観察に使用した.

なお,著者らはこの研究に関連したいかなる利益相反 も無い.

3. 結果と考察

3.1 アクリル板設置による音声波形の変化

アクリル板無しでの録音を対照としてアクリル板を設 置した場合の録音を聴き比べると音声全体がこもって (くぐもって) ぼやけた感じになり, いくつかの単語が 聞き取りにくくなったという印象を著者らは受けた.た だし、完全に聞き取れない単語があるということでは無 かった.特に母音については聞き取が難しいとは感じら れなかった.一方いくつかの子音,具体的には,無声破 裂音 (/t/, /k/, /p/ など) と有声破裂音 (/d/, /g/, /b/ など), 無声破擦音(/chi/, /tsu/ など)で聞き取りが難しくなる 傾向を感じた. 無声破裂音を子音とする/ta/と有声破裂音 を子音とする/ba/, そして無声破擦音である/chi/を含む文 である「~の立場を~」の部分の音声波形を示したのが Fig. 2 である. Fig. 2A にはこの部分全体の波形, Fig. 2B には注目した子音部分の拡大波形を示している. アクリ ル板無しの状態と有りの状態を比較するとアクリル板に よって波形の高周波成分が減弱していることが波形全体 から読み取れる.また,子音部分に注目すると/t/の特徴 である図中0.15 s付近の高周波の山谷がアクリル板によ り振幅が小さくなり数も減ることが見られた. より具体 的には、0.14 s から 0.16 s の間に見られる先行する/no/ の母音の反響と考えられる約5周期の基本振動に、複合 する形で/t/の成分である高周波の山谷が主なものだけで も 30 以上, しかもそこにはより高周波の成分も伴って見 られたのに対し、アクリル板によって/t/成分の振幅は大 きく減り 20 程度のなめらかな山谷になっていた. /chi/



Fig. 2 Waveforms of "no-ta-chi-ba-o". Comparison of control (no partition), partition, partition with window, and partition with PVDC film attached window. Whole waveforms (A), and enlarged regions of consonants (B).

については高周波の摩擦音に相当する波形がアクリル板 によってほぼ見えなくなり,先行する/ta/の母音部分との 境界をはっきりと特定するのが難しくなった.また,/ba/ については立ち上がりの破裂音部分(Fig. 2B 図中の矢 印)がアクリル板無しでははっきり見られるものの,ア クリル板有りでははっきりしなくなっていた.なお,こ れらそれぞれの音の部分だけを取り出して再生してみた ところ,アクリル板有りでは/ta/が/pa/に聞こえたり,/chi/ の認識が難しかったり,/ba/が/wa/のようにも聞こえたと いうのが著者らの印象だった.ただし,一連で再生する と「~の立場を~」と聞き取ることは可能だった.これ は先行する音によって聴覚の順応状態が変わるために音 の周波数帯域が変化することに聴覚が敏感であることと, これまでの言語学習によって不明瞭な部分を文脈で補っ て認識する ³ためと推測される.

母音の波形について見るとこちらも高周波成分の減弱 が見られた.しかし,母音それぞれの特徴を大きく決め る第1フォルマントと第2フォルマントの成分は日本語 では3.5 kHz までに収まっていると報告されており¹¹⁾, 母音の識別に重要なこれらの波形成分はほぼ保たれてい ることがアクリル板有無での波形の直接観察比較とスペ クトル解析の面(data not shown)から確認された.また, 母音は継続時間が長いため聴覚の神経処理としては一連 の繰返し周期内の時間微細構造を集積して認識につなげ ることになり,経過時間が短い子音成分より認識が容易 であると考えられる.また,再生に使用した元の音声フ ァイルの波形と比較したところ実験環境下での反響によ ると思われる母音成分の継続時間の延長が見られ,これ も母音の認識に有利にはたらくことが予想される.一方, これによって無声子音の前後に入っている無音部分に母 音の反響が重なってしまうことは,子音の認識を低下さ せる一因になっていることが考えられる.

3.2 音声波形に対する窓とフィルムの効果

アクリル板に窓を設け音声を記録した場合の波形デー タとその窓に PVDC フィルムを貼って記録した時の波形 を Fig. 2A,B の下 2 段に示した.これらに示されるよう に,アクリル板で少なくなった先行する母音の基本振動 に重複した/t/の高周波成分の山谷の数と振幅が,窓によ って部分的に回復されており,PVDC フィルム貼付でも その傾向は保たれていた./chi/では高周波成分の振幅が アクリル板で 1/6 程度になっていたものが,窓によって 1/3 程度にまで回復し,PVDC フィルム貼付によっても 1/4 程度の振幅が見られた.これによって破擦音として の開始時と摩擦音が認識しやすくなると考えられる.



Fig. 3 Waveforms of "bi-de-o". Comparison of control (no partition), partition, partition with window, and partition with PVDC film attached window.

/ba/については、/chi/の高周波成分が収まってからの/ba/ への移り変わりがアクリル板ではっきりしなくなってい たものが、窓によってはっきりするようになり、/ba/の 立ち上がり部分 (Fig. 2B 図中の矢印)の認識がしやすく なると考えられた.この傾向は PVDC フィルム貼付でも 保たれていた.

一方,母音について見ると窓によって高周波成分が回 復する傾向は見られるものの,全体的な振幅はアクリル 板無しの程度までは回復せず,窓無しのアクリル板有り とほぼ同じレベルであった.このことは音量的にはアク リル板設置による減少を今回の窓によっては回復させら れていないことを示している.

Fig. 3 は「ビデオ」という音声の波形を示したもので ある. アクリル板により有声破裂子音である/b/の立ち上 がり部分の高周波成分の振幅が減弱されている. また /de/の立ち上がり開始部(Fig. 3 図中の矢印)が不明確に なっている. このためか, アクリル板有りの音声を聴く と「ビオ」または「ビヨ」のようにも聞こえるという印 象を著者らは持った. これは, アクリル板の設置により /d/の開始部分が不鮮明になることと母音/e/から/o/に遷 移する部分も変化が不鮮明なために起きている可能性が

考えられる.日本語の母音の第1フォルマントと第2フ オルマントは, /e/では概ね 450 Hz と 2000 Hz , /o/では 概ね 430 Hz と 650 Hz とされており¹²⁾, /e/の第2フォル マントの認識がアクリル板によって難しくなったために 第1フォルマントの周波数が比較的近い/e/と/o/が区別し にくくなった可能性が考えられる. なお他の母音では, /a/が概ね790 Hzと1210 Hz, /i/が概ね280 Hzと2210 Hz, /u/が概ね 310 Hz と 1100 Hz とされており¹²⁾, これらは/e/ と/o/とは第1フォルマントが大きく異なることからこの 推測は妥当であると考えられる. アクリル板に窓を設け PVDC フィルム貼付したところ、/b/の立ち上りの高周波 波形がはっきりすること、/de/の開始部(Fig.3図中の矢 印)がはっきりすること、/e/と/o/の波形も高周波成分が 多かった状態から少ない状態へと波形が明確に変化する のが見られた.これらが「ビデオ」の聞き取りを明瞭に することに繋がっているものと思われる.

Fig. 4 は/ka/の波形全体を左の列に, /k/部分の拡大を右の列に示したものである. なお,縦軸も右の列で拡大されている. この図を見ると無声破裂子音である/k/の特徴的な振動は,およそ 10 ms あたり 16 個の山谷つまり約1.6 kHz であると推定される. この振動が母音/a/に先行し



Fig. 4 Waveforms of "ka". Comparison of control (no partition), partition, partition with window, and partition with PVDC film attached window. Right column indicates enlarged region of consonant /k/.

て入ることが/ka/の認識に必要であると思われる.この 子音部がアクリル板によって振幅が大きく抑制されてお り,山谷の数がはっきりしにくい時間領域が増えている. これらが/k/認識が難しくなる要因になると考えられる. 一方,窓に PVDC フィルム貼付したものでは/k/部分の振 幅に部分的な回復が見られており、認識しやすくなって いると考えられる. なお、実際に著者らが音声を聴いた 印象では、/k/の前がほぼ無音の状態であればアクリル板 を介した音声でも/k/を認識するのは容易であるが、/k/ に先行して母音がありその反響が長引くと/k/の認識が 難しくなるというものだった.例えば、単語中の/ka/の 部分だけを聴くと/dka/のよう感じられたり、/ku/が/kbu/ または/fu/のように感じられた例や、/ko/が/ho/や/po/に感 じられた例もあった. なお波形データは示さないが、こ こまでに示した以外の子音でアクリル板により認識が不 明瞭になると著者らに感じられた例としては、/gi/が/bi/ や/ni/または/i/と区別するのが難しくなった例,/ze/が/de/ と区別しにくくなった例、/hi/が/pi/と区別しにくくなっ た例, /tsu/が/zu/と区別しにくくなった例などが感じられ た.これらの子音の認識の明瞭化に対しても,窓に PVDC フィルム貼付した場合に一定の改善効果があると感じら れた.

4. おわりに

今回の測定方法は厳密な音響学的な計測ではない.し かし、単に一連の音声データを FFT により全体的なパワ ースペクトルを見ただけでは音声の認識に関わる要素で ある波形1周期内の山谷の構造,その経時変化,そして 特定の波形の継続時間といった分析は十分にはできない. 今回目的としたのは一般的に入手可能な機材で再現実験 が可能であり, 音波形の直接観察といった簡易的な方法 であっても音声伝達における聞き分けに重要となる子音 成分の修飾や継続時間の変化といった時間微細構造に関 わる要素を定性的に評価できることである.そして,そ の目的は達成されたと考えている.我々の研究室では既 にクラリネットの発音や音色の知覚に関わる波形要素の 見積もり13)や、アルトリコーダーで吹鳴された重音の知 覚に関わる波形要素の提案¹⁴⁾において、今回同様の波形 観察方法の有用性を示している.従って、本研究で行っ た測定・観察方法は、今後それぞれ具体的に異なるアク リルパーティションの設置環境においても、音声伝達の 良否を定性的に評価するための実用的な方法として提案 できたと考えている.これに加えて、本研究では次の事 も示すことができた.アクリル板は切削といった加工性 も高く窓を設けることは難しくない. PVDC フィルムは 薄くても強度があり破れにくく音声の透過性が良い一方, 飛沫の透過は防ぐ. PVDC フィルムはアクリル板にも密 着し、平面的に貼れば窓部分を介しての視認性も妨げに くい.しかも安価で入手しやすく,必要に応じて簡単に 張り替えられるので衛生的に使用できる.以上により,

アクリルパーティションに窓を設け PVDC フィルムを貼 るという方法は、聞き取りを簡易的に改善する方法とし て有効かつ実用的であると言えるであろう.

実際の会話の状況では様々な環境雑音や、他者の会話 が聞こえていることも多いであろうから、今回の実験条 件より更に聞き分けが難しい場面が多くなると考えられ る. アクリル板を使用していると聴取者の後ろから届い てくる音がアクリル板の反射により大きく聞こえること も体験される. そういった状況下では人は両耳機能を用 いて妨害音の中から聞きたい音声を音源定位によって聴 取する事が可能なことが知られている³⁾.しかし,アク リル板によって正面からの音が遮られてしまうと、視覚 情報から判断される正面である話者の位置と音源定位能 力による音声源の位置が一致しなくなってしまう.この ような場合でも、PVDC フィルム貼付の窓があれば、そ こを通して直接音が聴取者に届くことになり、より話者 の音声を選択的に認識することに有利になるものと予想 される. そのため今後は、環境雑音や他者の会話が聞こ えているような状況下で,被検者による実地試験を行い, アクリル板に PVDC フィルム貼付の窓を設けることの有 効性を様々な実環境下で具体的に評価する必要がある. なおそれと並行して,より聞き取りに優れたアクリルパ ーティションとして実用化するためには,聞き分けに重 要な子音成分を効果的に透過させられる窓の大きさや形 状そして位置について検討することも必要であろう. 高 齢者では老化により高周波域の聴力が低下し、同時に音 声を分析する能力も低下することが知られている³⁾.現 在多く使用されているアクリルパーティションでは音声 コミュニケーションに難しさを感じている人々がいるこ とを忘れずに改良を進めていく必要があるであろう.

参考文献

- 青木佐奈枝,小野聡士,福井晴那,川嶋真紀子: COVID-19 感染防止対策が心理支援にもたらした問題とその対応,心理学研究, Vol. 93, No.4, pp.359-365 (2022).
- 2) 久本誠一,樋口雅俊,田中均,藤井尚子,合田真理 子,上津遊恭平:水槽を併用した超音波エコー法に よる体肢断面観察法の検討,バイオメカニズム学会 誌, Vol. 34, No.1, pp.68-72 (2010).
- 廣谷定男(編著):聞くと話すの脳科学(日本音響学 会編,音響サイエンスシリーズ 17),コロナ社 (2017).
- M.S. Lewicki: Efficient coding of natural sounds, Nature Neurosci., Vol.5, No.4, pp.356-363 (2002).
- 5) E.C. Smith and M.S. Lewicki: Efficient auditory coding, Nature, Vol.439, pp.978-982 (2006)
- 6) B. C. J. Moore: The role of temporal fine structure processing in pitch perception, masking, and speech perception of normal-hearing and hearing-impaired people, J. Assoc. Res. Otolaryngol., Vol.9, pp.399-406

(2008).

- J.N. Oppenheim and M.O. Magnasco: Human time-frequency acuity beats the fourier uncertainty principle, Physical Review Letters, Vol.110, pp. 044301(1-5) (2013).
- 板谷実:プラスチックフィルムによる食品の包装, 調理科学, Vol.3, No.2, pp.73-78 (1970).
- 9) 市川和昭:食品包装の研究(第1報)プラスチック
 包装材料についての一考察,名古屋文理短期大学紀
 要, Vol.18, pp.101-107 (1993).
- 中尾卓:サランラップ®の製膜とフィルム特性,化
 学と教育, Vol.58, No.12, pp.558-561 (2010).

- T. Hirahara and R. Akahane-Yamada: Acoustic characteristics of Japanese vowels, Proc. ICA2004, pp.3287-3290 (2004).
- 12) 加藤重弘, 安藤智子: 基礎から学ぶ音声学講義, 研 究社, pp.223 (2016).
- 13) 堀越哲郎,藤原正明:クラリネットマウスピースの フェイシング部の微小形状変化が吹鳴音波形に与 える影響,東海大学紀要工学部, Vol.62, No.1, pp.35-42 (2022).
- 14) 堀越哲郎,藤原正明:アルトリコーダーで得られた 重音波形の時間構造に見られた特徴,東海大学紀要 工学部, Vol.59, No.2, pp.51-58 (2019).

アルカリ法によるプラスミド DNA 精製過程における溶液混和が 最終精製標品の品質に与える影響の検討

笹川 昇^{*1,3} 小林 響^{*2} 覧村 龍之介^{*2}

Effect of Solution Mixing Condition on the Quality of Isolated Plasmid DNA by the Alkaline-SDS Method

by

Noboru SASAGAWA^{*1,3}, Hibiki KOBAYASHI^{*2} and Ryunosuke MIMURA^{*2} (Received on Mar. 23, 2023 and accepted on Jul. 6, 2023)

Abstract

The alkaline-SDS method is the most popular and reliable way to isolate plasmid DNA from recombinant *Escherichia coli*. The principle of this method is a sudden and stepwise change of the pH of a solution containing plasmid DNA, bacterial genomic DNA, and proteins. At each step of the experiment, complete mixing of added solutions is required. On the other hand, the mixing condition of adding solution III (which neutralizes the pH of the sample) is ambiguous in the standard protocol and unfamiliar to beginners. Based on this background, we investigated the mixing condition of solution III and chloroform by the alkaline-SDS method. We tested four conditions of mixing solution III and chloroform, either gently or vigorously. Among these four conditions, we found that only gentle mixing resulted in the ideal high quality. Conditions with any vigorous mixing led to contamination of bacterial genomic DNA in the final product. Furthermore, we tested changing the volume of solution II, and also tested a vortex mixer as a mixing tool. The results provide a clear guideline for those who are inexperienced with alkaline-SDS plasmid purification.

Keywords: Plasmid DNA, Alkaline-SDS method, Solution mixing condition, Solution III, Chloroform

1. はじめに

分子生物学において,プラスミド DNA の精製は基礎 的かつ重要な実験である.精製度の高いプラスミド DNA を取得することが,その後の実験結果を左右すると言っ ても過言ではない.

プラスミド DNA の精製手法はいくつか存在するが, その中で主流となっているのはアルカリ法と呼ばれる精 製法である.アルカリ法によるプラスミド精製実験は学 生実習でも定番の実験であるし,分子生物学系の研究室 に配属された学生が一番初めに習得を目指す実験手法の ひとつとしても数えられる.

アルカリ法は 1979 年に Birnboim によって報告されて 以来¹⁾,いくつかの改変が行われ,現在では実験手順が 確立されている.現在はキット化されたプラスミド精製 試薬が販売されている場合も多いが,その手法の一番重 要な原理はキットであっても変わりがない.

既に確立された手法だというものの,アルカリ法によ る精製の際,加えた溶液の混和方法に迷う場合がある. この実験では様々な試薬組成の溶液を段階的かつ順番に 加えていくのだが,その際,加えた溶液をどのように混

- *1 工学部生物工学科 教授
- *2 工学部生命化学科 学部生
- *3 責任著者

和していくのかということが問題となることが生じるの である. Birnboim 原法では『gently mixed by inversion for a few seconds』となっている実験操作に対し、これを直 訳したであろう『数秒間ゆっくりと攪拌』としている実 験書もあれば²⁾, 他にも複数の実験書で『inverting the tube several times』³⁾, 『shake 10 times』⁴⁾, 『反転させて混合』⁵⁾, 『よく混ぜ』の,『ボルテックスミキサーで良く混合』7, 『激しく転倒させて充分に混和』⁸⁾などと様々な表現が されており,溶液をどの程度混和しても良いものなのか, 初心者には判断が難しい場合がある.このような事情も あり、アルカリ法によるプラスミド DNA 精製における 溶液混和の過程は,研究室ごとに変法(ローカルルール) が生じやすいところである.また学生実習の際にも『混 ぜると書かれているが,実際にどの程度の強さで混ぜれ ば良いのか分からない』と質問を受けやすい手順でもあ る.

このような状況を踏まえ、本研究では、アルカリ法に よるプラスミド精製の際に加える溶液の混和方法が最終 精製標品の精製度に与える影響について具体的な検討を 行った.今回の検討を行ったきっかけとして、一般的に 行われる手順通りに実験を進めたにもかかわらず、得ら れた精製プラスミド DNA の電気泳動を行うと、その品 質が低いことを示すスメアなバンドが泳動像に生じたこ とが挙げられる.そのスメアの原因として、アルカリ法 に使用される試薬のSolution IIIやクロロホルムの混和方 法の違いに関係性があると考え、その条件を検討した. 具体的な検討の手順として、アルカリ法を用いたプラス ミド精製実験で使用されるSolution IIIとクロロホルムの 混和方法を何通りかに変化させ、その後得られた精製標 品に対して吸光度測定やアガロース電気泳動を用いるこ とで精製度の評価を行うこととした.

2. 実験の概要

2.1 大腸菌およびプラスミド DNA

プラスミドは pBAD-GFPuv を用いた (Fig. 1). 宿主と なる大腸菌は K12 株由来の XL-1 Blue を用いた. pBAD-GFPuv はアンピシリン耐性遺伝子を保持するため, これを取り込んだ大腸菌(形質転換体)はアンピシリン 耐性を獲得する.この形質転換体をアンピシリン入りLB 培地に画線培養し、シングルコロニーを獲得した.この シングルコロニーを滅菌済み爪楊枝でつつき,200mL三 角フラスコに入った 50mL の滅菌済み 2×YT 培地に植菌 し、37℃で一晩の振盪培養を行った.翌日、培養済みの 形質転換体を 15mL 遠心チューブに 15mL ずつ分注し, 2500rpm, 室温で 20 分間遠心して大腸菌を沈殿させた. 遠心後の 15mL チューブから上清を完全に取り除き,沈 殿をチューブごと-30℃で凍結保存した.このような凍結 サンプルを一度に多数作成することにより、形質転換体 サンプルごとのばらつきを抑えた.なお、遠心後の上清 含め、遺伝子組換え実験の指針に従い、生じた全ての実 験廃棄物に対して次亜塩素酸ナトリウム処理を行った.



Fig. 1 Map of pBAD-GFPuv, a plasmid used in the experiment.

2.2 アルカリ法に用いる試薬類

調製に用いた試薬は全て特級を用いた.以下,調製した試薬の組成を以下に示す.

Solution I: 25mM Tris/HCl, 10mM EDTA, pH8.0

Solution II: 0.2N NaOH, 1% SDS

Solution III: 3M CH₃COOK, 15% v/v CH₃COOH

また,制限酵素, RNase および反応バッファーは Takara 社もしくは Nippon Gene 社の製品を用いた.

2.3 アルカリ法によるプラスミド精製 (1) Solution I, Solution II および Solution III の添加 アルカリ法によるプラスミド精製は,Birnboim の原 法¹⁾,および文献 2, 3, 7 に従って操作した. 2.1 の 15mL チューブに入った菌体に対して Solution I を 500µL 加え, 菌体を懸濁した.この際,ボルテックスミキサーなどの 懸濁装置を用いて激しく完全に懸濁した.次に Solution II を 1000µL 加えて,30 秒間,チューブを横に倒しながら 全体を混ぜ合わせ(倒立混和),溶液に粘性が出たことを 確認した後に,更に氷中で 5 分放置した.その後,Solution III を 750µL 加えた.Solution III を加えた後の混和条件に ついては 3.1 および 3.3 で詳述する.なお,本実験では Solution III を加えて混和した後に,Birnboim 原法にない クロロホルム処理を施している⁷⁾.この過程の混和条件 に関しても 3.1 および 3.4 に記載する.

2.4 アルカリ法によるプラスミド精製(2) Solution III およびクロロホルム添加後の処理(最終精製標品の 作製)

Solution III およびクロロホルムを添加して混和させた 後のサンプルを, 2,500rpm, 室温, 20 分間遠心分離さ せた. 遠心分離後, 全てのチューブ内で上から水層, 中 間層, 有機層の三層に分離していた. これらのチューブ から水層を回収した.回収した水層に対し、その容量に 対して 0.6 倍量から 1 倍量の 2-プロパノールを加え, 12,000rpm,4℃で15分間遠心分離した.遠心分離後,75% エタノールで沈殿を洗浄した. チューブからエタノール などの液体成分を完全に取り除き, 沈殿のみの状態にし たうえで、チューブ内を完全に乾燥させた. 乾燥後、チ ューブに 400 μ L の T¹⁰E¹ (10mM Tris/HCl, 1mM EDTA, pH8.0)を加えてピペッティングで沈殿物を溶解した(こ れを粗精製サンプルとする). この粗精製サンプルに 10mg/ml の RNase を 2µL 加え, ピペッティングの後に 37℃,2時間の反応を行った.その後,徐タンパク質の ためにフェノール・クロロホルム抽出を行ない、次いで 酢酸ナトリウム存在下でエタノール沈殿を行った. 沈殿 物を 75%エタノールで洗浄したのちに完全に乾燥させ, 最終的に100µLの純水に溶解させたものを最終精製標品 とした.

2.5 制限酵素処理およびアガロース電気泳動

プラスミド DNA 最終精製標品の確認のために制限酵素処理とアガロースゲル電気泳動を行った.用いた制限酵素と組合せは以下の4通りである.

・uncut(制限酵素切断無し,プラスミドDNAのみ)

- ・*Eco*RV (単一酵素切断)
- ·PstI (単一酵素切断)
- ・*Eco*R V, *Pst* I (二重切断)

反応時にはプラスミド DNA 最終精製標品を 2µL,制 限酵素を各々0.5µL,10 倍濃縮反応バッファー(10×H Buffer)を2µL加え,それぞれのチューブで反応系の全体 量が20µLとなるように滅菌水で調整した.これを37℃ で1時間保温した後,1%アガロースにおける電気泳動を 行った.電気泳動は80V,40mAの条件で80~100分間行 った.泳動時にサンプルに添加するローディングバッフ ァーの色素(ブロモフェノールブルー)がアガロースゲ ルの 2/3 程度の位置まで進んだところで泳動を止めた. 泳動後のアガロースゲルを臭化エチジウムで 40 分染色 した後に写真撮影を行った.

3. 結果

3.1様々な混和条件下で回収した最終精製標品の濃度 と純度

 2.3 までの手順で 750μL の Solution III を加えた試料を 全く同じ条件で4本用意したのち、以下の条件で混和を 行った.

 ①:試料の入った 15mL チューブのキャップ側を親指, 下側を中指で持ち,泡が立たない程度にゆっくりと 20
 秒間転倒混和(以下,穏やかに混和)

②:①と全く同条件でおだやかに混和

③:試料の入った 15mL チューブを片手で持ち,ふたが しっかりと閉まっていることを確認して泡が大量に立つ ように5秒間激しく混和(以下,激しく混和)

④:③と全く同条件で激しく混和

ここで穏やかに混和させた①②では、白い乳白色の不溶 物の出現を確認した.一方で激しく混和させた③④では ①②同様の乳白色の不溶物出現を確認したが、①②に比 べて混和後の溶液がやや白く濁っていた.

次に、①から④すべての 15mL チューブに対してクロ ロホルムを 500μL 加え、以下の操作を行った.

:穏やかに混和

2:激しく混和

③:穏やかに混和

④:激しく混和

ここでSolution IIIを加えて穏やかに混和した①②では不 溶物の全体量に変化が見られなかった.一方で,激しく 混和した③④では細かいサイズの不溶物が凝集し,混和 後の溶液の透明度が上昇することが観察された. 以上の作業により,

以上の1F来により,

①: Solution III, クロロホルムともに穏やかに混和

②: Solution III を穏やかに混和, クロロホルムを激しく 混和

③: Solution III を激しく混和, クロロホルムを穏やかに 混和

④: Solution III, クロロホルムともに激しく混和

という,互いに異なる混和条件の4サンプルを作成した. 以降,この4サンプルに対して全く同じ操作を行うこ

とで最終精製標品を得た. 得られた最終精製標品の濃度 と純度の測定には NanoDropTM1000 (Thermo Fisher)を用 いた.

Table 1 に,様々な混和条件下での最終精製標品の濃度 と純度を示す.一般的に核酸の濃度と純度は波長 260nm の吸光度 (OD260) によって算出され⁹, その値と波長 280nm の吸光度 (OD280)の比 (OD260/280) の値が 1.8以 上であればタンパク質の混入が無く純度の高い DNA だ と判断される.実験結果から,溶液混合に関して今回試 したいずれの条件によっても、タンパク質の混入が無く 高純度の DNA が得られたことを示唆する結果となった.

Table 1 Concentrations and qualities of isolated plasmid DNA with various mixing conditions of solution III and chlorofolm. (Solution I : II : III=1 : 2 : 1.5, n=3, mean \pm s.d.)

	Solution III	Chloroform	conc. μg /μL	OD260/280
1	gently	gently	4.62 ± 0.08	1.84 ± 0.02
2	gently	vigorously	$4.36 \!\pm\! 0.07$	1.89 ± 0.01
3	vigorously	gently	$4.31 \!\pm\! 0.09$	$1.91 \!\pm\! 0.02$
4	vigorously	vigorously	4.31 ± 0.04	1.90 ± 0.01



Fig. 2 Quality check of isolated plasmid DNA by restriction enzyme reaction and agarose gel electrophoresis. (Solution I : III = 1 : 2 : 1.5)

3.2様々な混和条件下で回収した最終精製標品の電気 泳動結果

Fig. 2 に、最終精製標品の電気泳動結果を示す. この 電気泳動像から、Solution III およびクロロホルムの添加 の際にいずれも穏やかに混和したサンプル①ではプラス ミド DNA 以外の不純物が取り除かれており,高品質のプ ラスミド DNA が精製できたことを示唆する結果が得ら れた.一方で,それ以外のサンプル②③④の混和条件で は,電気泳動時のバンドにスメアが認識された.つまり, Solution III およびクロロホルム添加後に激しく混和する 段階をひとつでも経ると,最終精製標品の品質が低下す ることが示唆された.

3.3 加える Solution II の容量が実験結果に与える影 響

文献 1, 2, 3, 7 では、加える Solution I, II, III の容 量比を 1:2:1.5 としている. 一方で、この容量比を 1:1:1 としている手法も知られている⁸⁾. 用いる試薬の容量を 抑えることで実験の操作性が向上することもあるため, 本研究では Solution I, II, III の容量比が 1:1:1.5 の条件 でも実験を行うこととした. Solution III の混和条件を含 め, Solution II の容量以外の条件は 3.1 と同一とした. な お,以下の①'から④'はそれぞれ3.1の①から④の実験 条件に対応する. Table 2 が示すように, ここでも Solution III 添加時の混和条件による濃度・純度の差は認められな かった. 一方で Fig. 3 で明らかなように、やはりここで も Solution III の添加時に穏やかに混和した条件で精製度 が高く、激しく混和するとスメアが生じることが見て取 れた. かつ, Solution I, II, III の容量比を 1:2:1.5 で精製 を行った時よりもスメアの度合いが濃くなっている結果 となった.

Table 2 Concentrations and qualities of isolated plasmid DNA with various mixing conditions of solution III and chlorofolm. (Solution I : III : III=1 : 1 : 1.5, n=3, mean \pm s.d.)

			/ /	· /
	Solution III	Chloroform	conc. μg /μL	OD260/280
①'	gently	gently	2.30 ± 0.96	$1.91 \!\pm\! 0.06$
②'	gently	vigorously	3.88 ± 0.24	1.90 ± 0.02
3,	vigorously	gently	3.78 ± 0.15	1.86 ± 0.02
④,	vigorously	vigorously	3.35 ± 0.91	1.88 ± 0.02

3.4 ボルテックスミキサーによる溶液混和の検討

溶液混和の条件検討の一環として、ボルテックスミキ サーによる溶液の攪拌を試みた. Solution III およびクロ ロホルムを加えた後の溶液混和時に、Scientific Industries 社の VORTEX-GENIE 2 を用いて作業した. この装置の の強弱つまみを 10 段階中の 10(最強)とし、以下の条 件で攪拌した.

⑤: Solution III 添加後5秒,クロロホルム添加後5秒
⑥: Solution III 添加後10秒,クロロホルム添加後10秒
⑦: Solution III 添加後15秒,クロロホルム添加後15秒
この攪拌条件以外は3.1と完全に同一の作業条件とし、

【2. 実験の概要】で示された手順で作業を行った. なお, ⑤⑥⑦の実験は Solution I, II, III の容量比を 1:2:1.5 で 行い,容量比を 1:1:1.5 で行ったものを⑤'⑥'⑦'とした. これらの最終精製標品⑤⑥⑦について濃度と純度を計測 した結果を Table 3 に, ⑤'⑥'⑦' の濃度と純度を Table 4 に示す. NanoDropTM1000 による吸光度測定の結果では,



Fig. 3 Quality check of isolated plasmid DNA by restriction enzyme reaction and agarose gel electrophoresis. (Solution I : III = III = 1 : 1 : 1.5)

ボルテックスミキサーに供した時間を変化させても濃度 や純度に大きな差は見られなかった.また,⑤⑥⑦を 3.2と同様に制限酵素消化およびアガロース電気泳動に 供した結果を Fig.3に,⑥'⑥'⑦'の電気泳動結果を Fig.4 に示す.ここから分かるように,Solution I, II, III の容 量比を1:2:1.5 で行った⑤⑥⑦の場合は,ボルテックスミ キサーにかける時間が 5 秒+5 秒 (延べ 10 秒)から 15 秒 +15 秒 (延べ 30 秒)の範囲では結果に大きな差が無く,い ずれの条件でも手動でおだやかに混和した①に比べてご くわずかなスメアが認められる結果となった.一方で容 量比を1:1:1.5 で行った⑤'⑥'⑦'の場合では(Fig.5),ボル テックスミキサーによる攪拌時間の長さに比例する形で スメアが出現していくことが判明した.ただし,スメア の度合いは②'③'④'に比べて軽微であった. Table 3 Concentrations and qualities of isolated plasmid DNA with various mixing conditions of solution III and chlorofolm by Vortex mixer.

(2010		1.2.1.0,1	2, mean = 2.a.)
	Solution III	Chloroform	conc. μg /μL	OD260/280
5	5sec	5sec	4.13 ± 0.23	1.91 ± 0.03
6	10sec	10sec	$4.24 \!\pm\! 0.02$	1.89 ± 0.01
\bigcirc	15sec	15sec	4.37 ± 0.14	1.89 ± 0.03

(Solution I : II : III=1 : 2 : 1.5, n=3, mean \pm s.d.)

Table 4 Concentrations and qualities of isolated plasmid DNA with various mixing conditions of solution III and chlorofolm by Vortex mixer.

(Solu	tion I : II : III	=1:1:1.5, n=	=3, mean \pm s.d.)
	Solution III	Chloroform	conc. μg /μL	OD260/280
5,	5sec	5sec	3.09 ± 0.40	1.96 ± 0.01
6,	10sec	10sec	3.57 ± 0.30	1.94 ± 0.03
⑦,	15sec	15sec	3.32 ± 0.29	1.96 ± 0.01



 Solution III : Vortex 5sec
 Solution III : Vortex 10sec

 Chloroform : Vortex 5sec
 Chloroform : Vortex 10sec



Fig. 4 Quality check of plasmid DNA by restriction enzyme reaction and agarose gel electrophoresis. (Vortex mixer, Solution I : II : III=1 : 2 : 1.5)



Fig. 5 Quality check of plasmid DNA by restriction enzyme reaction and agarose gel electrophoresis. (Vortex mixer, Solution I : II : III=1 : 1 : 1.5)

4. 考察

今回のアルカリ法によるプラスミド DNA の精製時に おいて検討した条件の中では, Table 1 の結果では今回の 検討条件間で精製純度に差が見られることは無かったも のの, Fig. 2 の結果から,最も精製度の高いプラスミド DNA を生成できる組み合わせは Solution III とクロロホ ルムのどちらも穏やかに混和する方法であることが判明 した.なお,Table 1 の結果より,①から④全ての最終精 製標品でタンパク質の混入は見られていない.またFig. 2 のサンプル②③④の泳動像から,制限酵素の有無によっ てスメアの状態に変化が見られることが分かる.従って, このスメアの要因は大腸菌ゲノム DNA の混入であり, このゲノム DNA が制限酵素消化によって更なる断片化 を受けて泳動像上のスメアとなったと考察される.それ に加え,①は当然のことながら,②③④でもプラスミド DNA が制限酵素消化を受けており,①から④全てのサン プルで制限酵素消化が問題なく進行していることが分かる.このことから,①から④全ての最終精製標品において有機溶媒等の残存混入は無いものと考えられる.

サンプル②③④で生じた大腸菌ゲノム DNA 混入の原 因を、アルカリ法によるプラスミド精製における Solution III とクロロホルムの役割という観点から考察す る. Solution III は、その溶液に含まれる酢酸カリウムと 氷酢酸によって緩衝作用を有している. その作用を通じ て Solution III は Solution II によって大きく塩基性に傾い た実験試料の pH を中和する役割を担っている. また Solution III 中の酢酸カリウムは Solution II に含まれてい る SDS と反応して不溶性のドデシル硫酸カリウム(PDS) を生成せしめる.この急激な中和作用と PDS の生成を通 じ, Solution II 中の NaOH の作用で変性した大腸菌のタ ンパク質やゲノム DNA が Solution III の添加によって不 溶性の不溶性画分に移行する. 一方でクロロホルムは上 述した不溶性画分の中に取り込まれている水分子を水層 側に移動させ、プラスミド DNA などを含む水層、タン パク質などの不溶物の層、クロロホルムの有機層の三層 に明確に分離する働きを担っている. 断片化した DNA の混入を起こす原因は, Solution III で生成された不溶物 に対して物理的に強い衝撃を加えることで不溶物の形が 崩れてしまい、その際に本来なら不溶性画分に分離され るはずの大腸菌ゲノム DNA が断片化してしまうことだ と考えられる. 断片化した DNA は, その後の精製作業 の過程でも取り除かれることなく、最終精製標品の中に 混入してしまう. 言いかたをかえれば、クロロホルムの 添加自体がスメアの原因と関係しているわけではなく, Solution III を加えた後に生じる不溶性画分に強い衝撃を 与える混和方法をしてしまうことが,大腸菌ゲノム DNA 混入の原因になってしまうと考えられる.

今回の実験では、加える Solution II の容量についても 検討を加えた.いわゆる常法では Solution I, II, III の容 量比を 1:2:1.5 として順次添加していくが、この容量比を 1:1:1.5 としても十分にプラスミド DNA が精製されるこ とが Fig. 3 より示唆される. 一方でこの容量比とした場 合, Solution III の混和の条件によってゲノム DNA 混入 の度合いが大きく変化することが判明した. Solution II は強塩基性の試薬であり, Solution III はそれを中和する 作用がある. そのため, Solution II を加える容量が相対 的に少なければ, Solution III を加えた際の中和反応がよ り速やかに進行すると思いきや、今回はその予想を覆す 結果となった.この結果について,現時点では様々な要 因を想定している.まず,反応系の最終的な液量がゲノ ム DNA の混入量に影響を及ぼしたことが考えられる. Solution III を加えたときに生じる不溶性画分は、時とし て反応溶液全体の速やかな混和を妨げる要因となりうる. 最終的な液量が十分にあるほうが、液体全体にわたる中 和反応を速やかに進行させ、結果としてゲノム DNA の 混入を抑制しているいう考え方も出来る. 次に考えられ ることとして、加える Solution II の量を変化させたこと により、ゲノム DNA の変性が不十分となっていた可能 性がある.ゲノム DNA の変性が不十分であった場合は, Solution III を加えてもゲノム DNA が不溶性画分に移行

せず,プラスミド DNA と共に回収されてしまう.ただし、この場合は穏やかな条件で混和した場合でも一定量のゲノム DNA 混入が起こると予想される.これらの事柄を明らかにするためには、Solution II を加えた時点でのpH変化や Solution III を加えて中和させた際のpH変化を逐一確認するなどの精査が必要である.また、プラスミド DNA を精製する際の菌体量や用いる容器の形状によっても実験結果が異なってくるかもしれず.これらの要因を総合的に条件検討する必要が生じてくる。

Solution III を加えた後の混合にはボルテックスミキサ ーを使用せよとする実験書⁷⁾もあるが, Fig.5 が示すよ うに、時と場合によってはボルテックスミキサーによる 過度な攪拌が大腸菌ゲノム DNA の混入の原因となりう ることが示唆された. ただし Fig. 5 は Solution I, II, III の容量比を 1:1:1.5 とした場合の結果である. いわゆる常 法における Solution I, II, III の容量比 (1:2:1.5)で実験を 行った Fig. 4 の場合では、同じようにボルテックスミキ サーによる攪拌を行ってもわずかにスメアが確認される のみであり、ゲノム DNA の顕著な混入は確認されなか った.これも意外なことに、手作業で行う溶液混和より もボルテックスミキサーによる溶液混和のほうが穏やか な条件であることが今回の実験によって示唆されるので ある. ただし、ボルテックスミキサーを用いて精製した サンプルでは、わずかではあるが電気泳動時にスメアが 確認され、今回の実験では加える Solution II の容量比に 関わらず手作業で穏やかに混和して精製したプラスミド の品質が一番高いという結果となった. アルカリ法によ るプラスミド精製時にこの程度のゲノム DNA の混入は 無視できるものとして, 誰でも確実に同程度の混和が可 能な手順としてボルテックスミキサーを用いる手法があ るのかもしれない.ただしこの場合も、実験に用いる容 器によって条件が左右される可能性は否定できない.誰 もが安定的に作業できる実験系の確立を目的とした場合, 引き続き今後の検討課題であると考えられる.

謝辞

実験を遂行するにあたり,議論に参加してくださいま した高橋凌眞さんに感謝申し上げます.また,日々の実 験に際して共に励まし合ってくださいました木村優未さ んに心より御礼申し上げます.

参考文献

- H.C. Birnboim and J. Doly: A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant plasmid DNA. Nucleic Acids Res. 7, pp.1513-1523 (1979).
- 2) 高木 昌宏:いまさら聞けないプラスミド抽出法の 原理,生物工学会誌, Vol.89, No.9, pp.544-548 (2011).
- J.F. Sambrook et al. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press, ISBN978-0879695774.
- 4) 豊島久眞男、山本雅 監修、東京大学医科学研究所 制癌研究部編:新細胞工学実験プロトコール、秀潤

社, ISBN4879621250.

- 5) 日本生化学会 編:基礎生化学実験法 4 核酸・遺伝子 実験 2 応用編,東京科学同人, ISBN9784807911844.
- 6) 村松正実,岡村博人 編:遺伝子工学ハンドブック, 羊土社, ISBN494639866X.
- 7) 中山広樹, 西方敬人:バイオ実験イラストレイテッ

ド②遺伝子解析の基礎,秀潤社, ISBN4879621498.

- 8) QIAGEN[®] Plasmid Purification Handbook, HB-1193-005
- 9) 柴山 祥枝:核酸 (DNA・RNA)の定量法 一吸光 光度分析法と蛍光法を中心に一,ぶんせき, Vol.523, pp.268-274 (2018).

新任教員紹介

工学部・講師・新井啓之

略歴

1998.3 東海大学工学部航空宇宙学科 卒業 2000.3 東海大学大学院工学研究科航空宇宙学専攻 卒業 2003.3 東海大学大学院工学研究科航空宇宙学専攻 満期退学 2003.4-2004.3 東海大学総合情報センター非常勤助手 2004.4-2022.3 東海大学理系教育センター非常勤講師 2017.4-2019.3 東海大学工学部航空宇宙学科航空宇宙学専攻 臨時職員 2020.4-2022.3 東海大学工学部航空宇宙学科航空宇宙学専攻 臨時職員 2023.4 現職



担当科目

プログラミング,情報処理実習,航空宇宙学実験1・2,ドローン操縦実習

研究活動内容

1. はじめに

航空工学分野を中心に流体力学や飛行力学に関する研究 テーマや、近年、高効率な単結晶シリコンセル、ブラシレ スモータやリチウムポリマー電池の活用により実現可能と なった長時間飛行が可能なソーラー無人飛行機開発に関す るテーマを手掛けている.

2. プロペラ表面の流れ測定¹⁾

2.1 概要

プロペラ駆動による推進は、低速での推進機構としては 極めて効率が高く、Reynolds 数が 10⁴ から 10⁶ 前半の領域 においては、推進機構の主体として活躍している.

ブレードの設計に於いて、ブレード表面での流れ、及び プロペラ後流、すなわち縮流、翼端渦、渦層の移動がその 性能を決定する上で極めて重要である.本実験では、低レ イノルズ数領域に適した断面翼型を有するプロペラブレー に対して、回転中のブレード周りの流れに関する計測とし て、ブレード表面の圧力測定、タフトによるブレード表面 の流向調査を行った.

低 レイノルズ数 領域下でのブレード形状は Adkins-Liebeck による最適形状設計法を使用し, Reynolds 数10⁵の条件でブレード形状を決定しFig.1のブレードを製 作した.

東海大学工学部航空宇宙学科の低速風洞試験設備を使用



Fig. 1 Propeller blade for low Reynolds flow.

し、6分力天秤に駆動系一式を取り付け,推力を、プロペ ラとACモータの間に設置したトルクメータを用いてトル クを測定した.

また、プロペラ表面に等間隔に空けた圧力測定孔(1ブ レードあたり319孔)を通してプロペラ駆動中の表面圧力 分布の測定も行った.プロペラ回転下で測定された圧力は 遠心力の影響を受けるため、測定後に遠心力による圧力寄 与分を差し引いている.

2.2 圧力測定

Fig. 2 より, ブレード端ほど翼弦方向に沿った圧力変化 は大きいことが分かる.また,ブレード端の後縁付近では, 局所的に等高線の粗密が変化している箇所が見られ,流れ の剥離と再付着が小規模で発生するショートバブル²⁾の



Fig. 2 Pressure distribution by direct measurement.

発生が考えられ,等高線が粗になっている部分では,剥離 後に死水領域が存在し,また等高線が密になっている部分 の直後では再付着していると考えられる.

2.3 タフトによる流れ

ブレード表面にタフトを取り付け回転中のタフトの様子 をストロボ撮影した図 d を元に、遠心力によるタフトの曲 げを考慮し、表面での流れの向きを評価した.設計値より も効率が低下する要因として、ショートバブルなど3次元 的流体現象の発生が確認できた.

3. ソーラー無人飛行機

3.1 機体開発

東海大学とサウジアラビア・キングアブドゥルアズィー ズ大学(以下 KAU)との共同研究プロジェクトdでは、ソ ーラー無人飛行機 SunFalcon1(翼幅 3.7m, 全長 3.2m)及 び SunFalcon2(翼幅 7.6m, 全長 3.0m)について、概念設 計 ³⁾や詳細設計等の機体設計を担当し、空力、構造、駆動 系および発電系など全般に亘る幅広い知見を得た.



Fig.3 Solar UAV "SunFalcon1".



Fig.4 Solar UAV "SunFalcon2".

また,2017 年度~2019 年度の NEDO プロジェクト「ロ ボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロ ジェクト」でのソーラー無人機開発(主体:スカパーJSAT) では再委託先のJAXA, NICTと共に東海大学の一員として, ソーラー無人飛行機の概念設計や基本設計等の機体設計 (空力,材料,構造,駆動系および発電系など全般)を担 当した.



Fig. 5 Solar UAV "SolarPhoenix".

3.2 エネルギーミュレーション

ソーラー無人飛行機の開発の元となる概念設計では,機体構造や重量の推算と併せて,エネルギー収支の算定が重要である.直射光・散乱光分離型の日射量モデルを用い, セル温度やフィルムによる反射モデルと,機体の姿勢角変 化を組み合わせることにより,発電と消費電力に関するエネルギーシミュレーション4を構築した.

参考文献

- 新井啓之 and 平岡克己: 低レイノルズ数流れでのプロペラブレード表面の圧力とタフト測定に基づく流体 解析,航空宇宙学会論文集 Vol. 57, No.662, pp.98-109 (2009).
- 2) 李家賢一: 翼型上に生ずる層流剥離泡, ながれ, Vol. 22, pp.15-22(2003.
- Nobuyuki ARAI and Katsumi HIRAOKA: Conceptual Design of Solar UAV for Long Endurance, 29th International Congress of the Aeronautical Sciences(2014).
- 4) 山下善基,新井啓之,佐川耕平 and 木村英樹:,太陽電 池を搭載した固定翼無人航空機の姿勢を考慮した発電 電力シミュレーション,2021年電気学会産業応用部門 大会前刷り集(2021).

	東海	毎大	学工学	之部紀]	要委員	₹	21		
委員長 委 員	高稲奥磯淺	橋田山村香	r 手信淳夫隆		金 万 <i>零</i>	鈴 戎 菊	木田川	昌正久	和敬夫
EDITORIA Th	AL CO IE SCI T	OMMI HOOI OKAI	TTEE C L OF EN L UNIV	OF PROC Igineef Ersity	EEDING	GS F	OF		
Chairman	1	Tetsu	ο ΤΑΚΑ	HASHI					
Members		Yoshi	nobu I	NADA			Masa	kazu	SUZUKI
		Atsus	hi OKU	YAMA		,	Taka	yosh	i NARITA
		Masao Takas	o ISOM hi ASA	JRA KA			Hisa	o Kik	UGAWA
本約	記要は	、学行	析刊行詞	志である	。揭載	可。	と判決	定	
され	ぃた原	著論	文で工	学部紀要	委員会	で	査読	•	
審査	査を受	けてい	いる。						

東	侮 大	学	紀	要	工学部
Vol. 63	. No. 1	2023			
2023年9	9月30日				
発行者	東海大学⊒ 〒259-1292 School of Eng	C学部 神奈川県平 ineering Tc	^工 塚市北金目 kai Univers	∃4丁目1≹ sity	番1号
	4-1-1 Kitakan Japan	ame, Hirats	uka-shi, Ka	nagawa-ken	1.